

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2014-65853

(P2014-65853A)

(43) 公開日 平成26年4月17日(2014.4.17)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
<b>CO8F 2/46 (2006.01)</b>	CO8F 2/46	4J011
<b>CO8F 230/08 (2006.01)</b>	CO8F 230/08	4J100
<b>CO8F 220/10 (2006.01)</b>	CO8F 220/10	

審査請求 未請求 請求項の数 12 O L (全 46 頁)

(21) 出願番号	特願2012-213443 (P2012-213443)	(71) 出願人	000003182
(22) 出願日	平成24年9月27日 (2012.9.27)		株式会社トクヤマ
			山口県周南市御影町1番1号
		(72) 発明者	梅川 秀喜
			山口県周南市御影町1番1号 株式会社トクヤマ内
		(72) 発明者	佐藤 誠
			山口県周南市御影町1番1号 株式会社トクヤマ内
		Fターム(参考)	4J011 QA03 QA12 QA43 SA05 SA06 UA01 VA01 WA01 WA07 4J100 AL08P AL08Q AL66P BA02P BA71Q BC43P BC48P CA04 FA27 JA46

(54) 【発明の名称】 光硬化性ナノインプリント用組成物およびパターンの形成方法

(57) 【要約】

【課題】 塩素系ガスのエッチング耐性に優れ、生産性、及び長期間保存安定性に優れた光硬化性ナノインプリント用組成物を提供する。さらには、比較的低い圧力で金型を押し当てた場合でも、パターンの転写が容易にでき、且つ、該パターンの基材との密着性が良く、金型からの離型性が良い等、ナノインプリントパターン転写性が良好な光硬化性ナノインプリント用組成物を提供する。

【解決手段】 光硬化性ナノインプリント用組成物は、(A)(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物、(B)ヘテロポリ酸、(C)(メタ)アクリル基を有する重合性単量体、(D)光重合開始剤を含んでなる。さらに、(E)有機珪素化合物、および/または(F)フッ素化有機シラン化合物を含んでもよい。

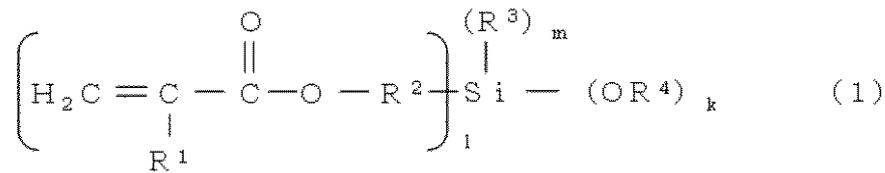
【選択図】 なし

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

(A) 下記式(1)

## 【化 1】



10

(式中、

R<sup>1</sup> は、水素原子、またはメチル基であり、R<sup>2</sup> は、炭素数 1 ~ 20 のアルキレン基または炭素数 3 ~ 10 のシクロアルキレン基であり、R<sup>3</sup> は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、炭素数 3 ~ 4 のシクロアルキル基、または炭素数 6 ~ 12 のアール基であり、R<sup>4</sup> は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基または炭素数 3 ~ 4 のシクロアルキル基であり、

l は 1 ~ 3 の整数であり、m は 0 ~ 2 の整数であり、k は 1 ~ 3 の整数であり、

l + m + k は 4 であり、

R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup> および R<sup>4</sup> がそれぞれ、複数存在する場合には、複数の R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup> および R<sup>4</sup> は、それぞれ、同種又は異種の基であってもよい) で示される(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物、

20

(B) ヘテロポリ酸、

(C) (メタ)アクリル基を有する重合性単量体、並びに

(D) 光重合開始剤

を含有する光硬化性ナノインプリント用組成物。

## 【請求項 2】

前記(B)ヘテロポリ酸が下記式(4)で表されることを特徴とする請求項1記載の光硬化性ナノインプリント用組成物。



30

(式中、M はケイ素、リン、ホウ素より選ばれる一種又は二種の元素から成るヘテロ元素を表し、M' はタングステン、モリブデン、ニオブ、バナジウムより選ばれる一種以上のポリ元素を表し、r は 10 ~ 100 の整数、m は 1 ~ 10 の整数、n は 6 ~ 40 の整数、x は 1 ~ 10 の整数、y は 0 ~ 50 の整数を示す。)

## 【請求項 3】

前記(B)ヘテロポリ酸がケイタングステン酸であることを特徴とする請求項1記載の光硬化性ナノインプリント用組成物。

## 【請求項 4】

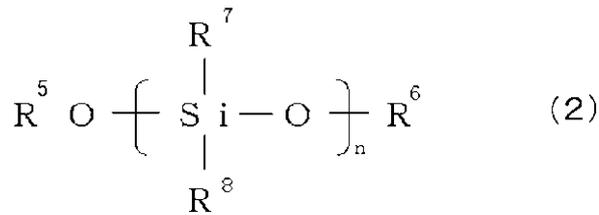
前記(メタ)アクリル基を有する重合性単量体(C) 100 質量部に対して、前記(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A) 3 ~ 300 質量部、前記ヘテロポリ酸(B) 0.1 ~ 50 質量部、及び前記光重合開始剤(D) 0.1 ~ 10 質量部を含むことを特徴とする請求項1 ~ 3 のいずれか1項に記載の光硬化性ナノインプリント用組成物。

40

## 【請求項 5】

さらに、(E) 下記式(2)で示される有機珪素化合物を含有することを特徴とする請求項1 ~ 4 のいずれか1項に記載の光硬化性ナノインプリント用組成物。

## 【化 2】



(式中、 $\text{R}^5$ 、 $\text{R}^6$  は同種又は異種の炭素数 1 ~ 4 のアルキル基または水素であり、 $\text{R}^7$  はアリール基であり、 $\text{R}^8$  はアリール基または炭素数 1 ~ 4 のアルコキシ基であり、 $n$  は 1 ~ 10 の整数である。)

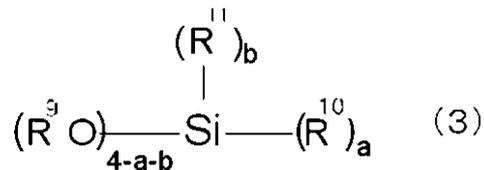
## 【請求項 6】

前記(メタ)アクリル基を有する重合性単量体(C) 100質量部に対して、前記(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A) 3 ~ 300質量部、前記ヘテロポリ酸(B) 0.1 ~ 50質量部、前記有機珪素化合物(E) 10 ~ 400質量部、及び前記光重合開始剤(D) 0.1 ~ 10質量部を含むことを特徴とする請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の光硬化性ナノインプリント用組成物。

## 【請求項 7】

さらに、下記式(3)で示されるフッ素化有機シラン化合物(F)を含有することを特徴とする請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項に記載の光硬化性ナノインプリント用組成物。

## 【化 3】



(式中、

$\text{R}^9$ 、および  $\text{R}^{11}$  は、それぞれ、炭素数 1 ~ 10 のアルキル基、または炭素数 3 ~ 10 のシクロアルキル基であり； $\text{R}^{10}$  は、炭素数 1 ~ 100 の含フッ素アルキル基、含フッ素シクロアルキル基、または含フッ素アルコキシエーテル基であり； $a$  は 1 ~ 3 の整数であり、 $b$  は、0 ~ 2 の整数であり、ただし、 $a + b = 1 ~ 3$  であり； $\text{R}^9$ 、 $\text{R}^{10}$  および  $\text{R}^{11}$  がそれぞれ複数存在する場合には、複数の  $\text{R}^9$ 、 $\text{R}^{10}$  および  $\text{R}^{11}$  は、それぞれ同一であっても、異なる基であってもよい。)

## 【請求項 8】

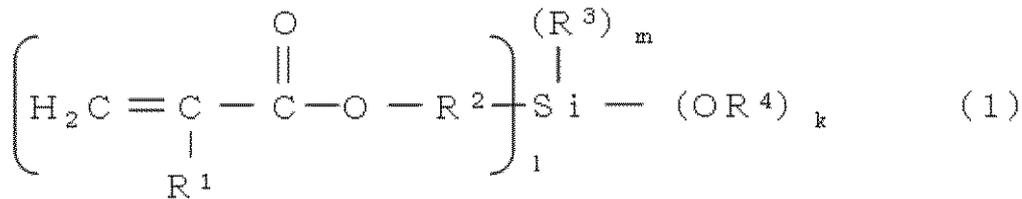
前記(メタ)アクリル基を有する重合性単量体(C) 100質量部に対して、前記フッ素化有機シラン化合物(F) 0.001 ~ 4質量部、前記(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A) 3 ~ 300質量部、前記ヘテロポリ酸(B) 0.1 ~ 50質量部、前記有機珪素化合物(E) 10 ~ 400質量部、及び前記光重合開始剤(D) 0.1 ~ 10質量部を含むことを特徴とする請求項 7 記載の光硬化性ナノインプリント用組成物。

## 【請求項 9】

少なくとも下記(A) ~ (D)成分を混合することにより得られてなる光硬化性ナノインプリント用組成物。

(A) 下記式(1)

## 【化 4】



(式中、

R<sup>1</sup> は、水素原子、またはメチル基であり、

R<sup>2</sup> は、炭素数 1 ~ 20 のアルキレン基または炭素数 3 ~ 10 のシクロアルキレン基であり、

R<sup>3</sup> は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、炭素数 3 ~ 4 のシクロアルキル基、または炭素数 6 ~ 12 のアリール基であり、

R<sup>4</sup> は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基または炭素数 3 ~ 4 のシクロアルキル基であり、

l は 1 ~ 3 の整数であり、m は 0 ~ 2 の整数であり、k は 1 ~ 3 の整数であり、

l + m + k は 4 であり、

R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup> および R<sup>4</sup> がそれぞれ、複数存在する場合には、複数の R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup> および R<sup>4</sup> は、それぞれ、同種又は異種の基であってもよい) で示される (メタ) アクリル基を有する有機珪素化合物、

(B) ヘテロポリ酸、

(C) (メタ) アクリル基を有する重合性単量体、並びに

(D) 光重合開始剤。

## 【請求項 10】

請求項 1 ~ 9 のいずれか 1 項に記載の光硬化性ナノインプリント用組成物を基板上に塗布し、該組成物からなる塗膜を形成する工程、

パターンが形成された金型のパターン形成面と前記塗膜とを接触させ、その状態で光を照射して塗膜を硬化させる工程、

前記金型を、硬化した塗膜から分離して、前記金型のパターン形成面に形成されているパターンに対応するパターンを基板上に形成する工程

を含むことを特徴とするパターンの形成方法。

## 【請求項 11】

基板がサファイア基板であって、請求項 10 記載のパターンの形成方法により基板上に形成したパターンをマスクとして、基板表面を塩素系ガスによりドライエッチングして加工することを特徴とする表面加工サファイア基板の製造方法。

## 【請求項 12】

請求項 1 ~ 9 のいずれか 1 項に記載の光硬化性ナノインプリント用組成物の硬化体を有するナノインプリント用レプリカ金型。

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、新規な光硬化性ナノインプリント用組成物に関し、さらに、前記光硬化性ナノインプリント用組成物を用いて基板上にパターンを形成する新規なパターン形成方法に関する。また、本発明は、該組成物の硬化体からなる新規なナノインプリント用レプリカ金型に関する。

## 【背景技術】

## 【0002】

近年、半導体集積回路は、より微細化され、高精度なものが要求されているが、このような微細加工は、高精度の半導体集積回路の他にも光反射防止性付与や LED 基板における光取り出し効率向上等の光学・照明用途や、2 次電池、太陽電池、燃料電池等のエネル

10

20

30

40

50

ギー開発、バイオテクノロジー等、多岐の用途において、インプリント技術による微細加工が盛んに検討されている。

【0003】

インプリント技術とは、基板上に形成したいパターンに対応するパターンの凹凸を有する金型を、基板表面に形成された塗膜上に型押し、剥離することにより、所望のパターンを該基板表面に転写する工程からなり、低コストで量産化が可能な微細加工技術として期待されている。

この技術を使用することによって、ナノオーダーの微細なパターンを形成することができる。インプリント技術の中でも、特に、数ナノ～数百ナノメートル（nm）の超微細なパターンを形成する技術はナノインプリント技術と呼ばれている。

10

【0004】

このナノインプリント技術について、その方法は、基板表面に形成する塗膜材の特性により2種類に大別される。その1つは、パターンが転写される塗膜材を加熱して塑性変形させた後、金型を押し付け、冷却して、塗膜材を硬化させることによって、パターンを転写する熱ナノインプリントの方法である。また、他の1つは、金型又は基板の少なくとも一方が光透過性であるものを使用し、基板上に塗膜材として液状の光硬化性組成物を塗布して塗膜を形成し、金型を押し付けて塗膜と接触させ、ついで、金型又は基板を介して光を照射して該塗膜材を硬化させることによって、パターンを転写する方法である。これらの中でも、光照射によりパターンを転写する光ナノインプリントの方法は、高精度のパターンを形成できるものであるため、ナノインプリント技術において広く利用されるようになっており、該方法に好適に用いられる光硬化性組成物の開発が進められている。

20

【0005】

ナノインプリント技術においては、基材表面と塗膜を硬化させて得られるパターンとの密着性、および該パターンと金型との離型性が重要になる。金型からの離型性については、金型表面にフッ素系処理剤で表面処理を施して離型性を付与したり、光硬化性組成物と金型の界面にペンタフルオロプロパンガス等のフッ素系ガスを介在させてインプリントする技術が一般的に知られている。一方、基材との密着性は、基材表面を表面処理したり、易接着層を設けたり、光硬化性組成物の組成変更によって改善が試みられている。基板との密着性と金型からの離型性は、相反する特性であるが、生産性を高めるためにより一層の改善が望まれている。

30

塗膜材自体に、この相反する特性を持たせるために、塗膜材中にフッ素系界面活性剤やシリコン化合物を添加する提案がなされている（特許文献1参照）。しかしながら、基板との密着性の低下や、表面に添加剤がブリードアウトする等の問題があり、基板との密着性と金型からの離型性の両立という点では、未だ改善の余地があった。

【0006】

また、ナノインプリント技術は、金型にてパターンを転写し光硬化した塗膜材（以下、硬化膜とする場合もある）を元に、基板に所望のパターンを形成するものである。基板にパターンを形成するには、酸素ガス、フッ素系ガス、塩素系ガス等により、硬化膜、及び基板のドライエッチングを行う。このようなドライエッチング処理では、基板を保護するパターンニングされた硬化膜もエッチングされることから、基板と硬化膜とのエッチング速度比が重要となる。そのため、種々のパターンニングを行う上で、上記のガスにエッチングされ難い硬化膜となる光硬化性組成物の開発が数多くなされている。（以下、この特性をエッチング耐性とする場合もある）。

40

【0007】

LED基板における光取り出し効率を向上させるために、サファイア基板表面上の凹凸加工により、素子からの光の全反射を抑制したり、サファイア基板表面上に積層するGaN層の結晶欠陥を低下させることが検討されている。サファイア基板表面上に凹凸加工する方法として、マスクを用いてシリカを蒸着し、シリカ蒸着パターンをマスクとしてウェットエッチング処理による方法や、フォトリソグラフィでレジストパターンを形成し、その後、ハードマスク堆積とリフトオフによってメタルマスクを形成してドライエッチング処

50

理を行う方法が一般的に用いられている。これらの方法で得られる基板は、Patterned Sapphire Substrates ( P S S ) と言われ、サファイア表面にマイクロオーダーの凹凸パターンを付与している。近年、LED光源のより一層の発光効率向上を目的として、可視光の波長以下の100～500nm程の凹凸パターンをサファイア表面上に付与し、全反射による横方向への伝播を抑制することが検討されており、その方法として、ナノインプリントにてサファイア基板表面上に硬化膜のパターンを形成し、それをマスクとして、ドライエッチング処理でサファイア表面に凹凸パターンを付与する方法が挙げられる。

#### 【0008】

サファイアのドライエッチングに使用するガスとしては、塩素系ガスが一般的で、パターン形成に使用する光硬化性組成物の硬化膜樹脂に塩素エッチング耐性が高いことが求められる。塩素エッチング耐性の向上には、フリーの炭素源が最少にできることから芳香族化合物が有効と考えられている。芳香族系高分子を用いた熱ナノインプリントの方法が有効であるが、工程上、パターンが転写される塗膜材を加熱して塑性変形させた後、金型を押し付け、冷却して、塗膜材を硬化させることによって、パターンを転写するため、生産性に課題があった。生産性の観点から、アリアル置換基を有する重合性単量体や樹脂および脂環式化合物を含む光硬化性組成物が提案されている(特許文献2～4参照)。しかしながら、塩素エッチング耐性を向上させるためには、アリアル置換基を有する重合性単量体や樹脂および脂環式化合物のような剛直な骨格を有した単量体を含むことが有効と考えられるが、サファイア基板との密着性や、粘度が高くなるため低圧力でのナノインプリントパターン転写性という点で改善の余地があった。これらの課題を解決するため、本発明者らは、特定の構造を有する有機珪素化合物、(メタ)アクリル基含有珪素化合物、金属アルコキシドを特定の量の水で加水分解した部分加水分解物を配合した光硬化性ナノインプリント用組成物を提案した(特許文献5参照)。

#### 【先行技術文献】

#### 【特許文献】

#### 【0009】

- 【特許文献1】特開2008-19292号公報
- 【特許文献2】特開2009-218550号公報
- 【特許文献3】特開2011-157482号公報
- 【特許文献4】特開2008-246876号公報
- 【特許文献5】特開2012-109551号公報

#### 【発明の概要】

#### 【発明が解決しようとする課題】

#### 【0010】

ところが、本発明者らの検討によれば、特許文献5に記載の光硬化性ナノインプリント用組成物は、分散性のよい組成物で、生産性や基板密着性や転写性に優れ、酸素ガスやフッ素系ガスに対するエッチング耐性も良好であるものの、塩素系ガスに対するエッチング耐性について、改善の余地があった。

#### 【0011】

また、特許文献5に記載の光硬化性ナノインプリント用組成物は、金属アルコキシドを水存在下において保存しているため、金属アルコキシドの加水分解反応に基づくゲル化、沈殿物が生じ、長期間保存安定性に改善の余地があった。このように、金属アルコキシドは、エッチング耐性を向上させるのに有効な成分であるものの、長期間保存安定性を悪くする一要因となっていた。このような観点から、長期間保存安定性が良好であると同時に、エッチング耐性、特に塩素に対するエッチング耐性の高い光硬化性ナノインプリント用組成物が求められていた。

#### 【0012】

本発明の目的は、パターンと基材との密着性や転写性が良いという従来技術の物性を維持しつつ、塩素系ガスのエッチング耐性に優れ、長期間保存安定性に優れた光硬化性ナノインプリント用組成物を提供することにある。

## 【課題を解決するための手段】

## 【0013】

本発明者は、塩素系ガスのエッチング耐性、及び長期間保存安定性に優れ、ナノインプリントパターン転写性を向上させるため、種々検討を行った。その結果、ヘテロポリ酸を用いることによって、長期間保存安定性を良好に保ちつつ、塩素系ガスに対するエッチング耐性を向上できることを見出し、本発明を完成するに至った。

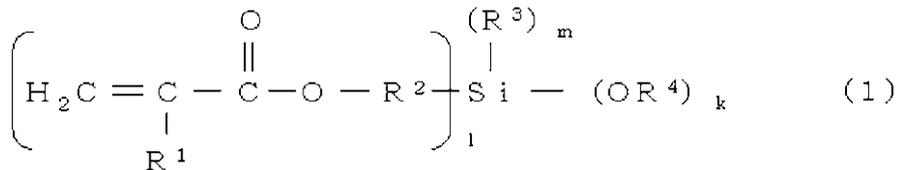
## 【0014】

すなわち、本発明は、

(A) 下記式(1)

## 【0015】

【化1】



## 【0016】

(式中、

R<sup>1</sup> は、水素原子、またはメチル基であり、

R<sup>2</sup> は、炭素数1~20のアルキレン基または炭素数3~10のシクロアルキレン基であり、

R<sup>3</sup> は、炭素数1~4のアルキル基、炭素数3~4のシクロアルキル基、または炭素数6~12のアリール基であり、

R<sup>4</sup> は、炭素数1~4のアルキル基または炭素数3~4のシクロアルキル基であり、

l は1~3の整数であり、m は0~2の整数であり、k は1~3の整数であり、

l + m + k は4であり、

R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup> および R<sup>4</sup> がそれぞれ、複数存在する場合には、複数の R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup> および R<sup>4</sup> は、それぞれ、同種又は異種の基であってもよい) で示される(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物、

(B) ヘテロポリ酸、

(C) (メタ)アクリル基を有する重合性単量体、および

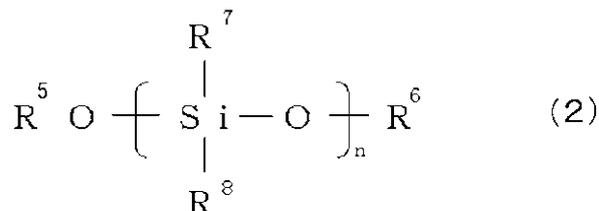
(D) 光重合開始剤

を含有する光硬化性ナノインプリント用組成物であり、さらに、

(E) 下記式(2)

## 【0017】

【化2】



## 【0018】

(式中、

R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup> は同種又は異種の炭素数1~4のアルキル基または水素であり、

R<sup>7</sup> はアリール基であり、R<sup>8</sup> はアリール基または炭素数1~4のアルコキシ基であり、

n は1~10の整数である。)

10

20

30

40

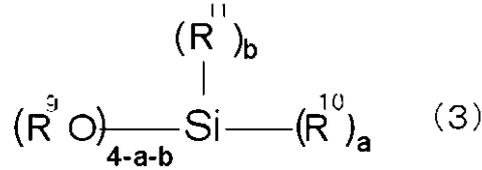
50

で示される有機珪素化合物を含有することが好ましく、

(F) 下記式(3)

【0019】

【化3】



10

【0020】

(式中、

R<sup>9</sup>、およびR<sup>11</sup>は、それぞれ、炭素数1~10のアルキル基、または炭素数3~10のシクロアルキル基であり；R<sup>10</sup>は、炭素数1~100の含フッ素アルキル基、含フッ素シクロアルキル基、または含フッ素アルコキシエーテル基であり；aは1~3の整数であり、bは、0~2の整数であり、ただし、a+b=1~3であり；R<sup>9</sup>、R<sup>10</sup>およびR<sup>11</sup>がそれぞれ複数存在する場合には、複数のR<sup>9</sup>、R<sup>10</sup>およびR<sup>11</sup>は、それぞれ同一であっても、異なる基であってもよい。)で示されるフッ素化有機シラン化合物を含有しても良い。

【0021】

20

第二の発明は、

前記光硬化性ナノインプリント用組成物を基板上に塗布し、該組成物からなる塗膜を形成する工程、

パターンが形成された金型のパターン形成面と前記塗膜とを接触させ、その状態で光を照射して塗膜を硬化させる工程、

前記金型を、硬化した塗膜から分離して、前記金型のパターン形成面に形成されているパターンに対応するパターンを基板上に形成する工程

を含むことを特徴とするパターンの形成方法である。

【0022】

30

第三の発明は、

基板がサファイア基板であって、前記パターンの形成方法により基板上に形成したパターンをマスクとして、基板表面を塩素系ガスによりドライエッチングして加工することを特徴とする表面加工サファイア基板の製造方法である。

【0023】

なお、本発明において、(メタ)アクリル基とは、メタクリル基又はアクリル基を意味する。

【発明の効果】

【0024】

40

本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物は、分散性が良く、該組成物を塗膜とし硬化させた後の硬化膜の基材密着性、及び転写性が良好という従来技術の物性を維持しつつ、塩素系ガスのエッチング耐性に優れた硬化膜を形成するのに、好適で、且つ長期間保存安定性にも優れた組成物である。さらに、フッ素化有機シラン化合物を含有させることで、上記効果に加えて、金型との離型性に優れた組成物となる。

【発明を実施するための形態】

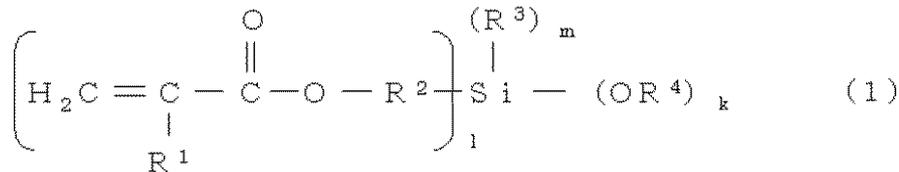
【0025】

本発明は、光硬化性ナノインプリント用組成物に関するものであり、

(A) 下記式(1)

【0026】

## 【化4】



## 【0027】

(式中、

R<sup>1</sup>は、水素原子、またはメチル基であり、R<sup>2</sup>は、炭素数1～20のアルキレン基または炭素数3～10のシクロアルキレン基であり、R<sup>3</sup>は、炭素数1～4のアルキル基、炭素数3～4のシクロアルキル基、または炭素数6～12のアリール基であり、R<sup>4</sup>は、炭素数1～4のアルキル基または炭素数3～4のシクロアルキル基であり、

lは1～3の整数であり、mは0～2の整数であり、kは1～3の整数であり、

l + m + kは4であり、

R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>がそれぞれ、複数存在する場合には、複数のR<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>は、それぞれ、同種又は異種の基であってもよい)で示される(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物、(B)ヘテロポリ酸、(C)(メタ)アクリル基を有する重合性単量体(以下、単に、(C)重合性単量体ともいう)、並びに(D)光重合開始剤を含むものである。

## 【0028】

なお、本発明において、ナノインプリントとは、5nm以上100μm以下のパターン、更には、5nm以上500nm以下の微細なパターンを良好に形成できるものを指す。ただし、当然のことながら、本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物は、100μmを越えるパターンの形成にも使用できる。

## 【0029】

以下、順を追って説明する。まず、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)について説明する。

## 【0030】

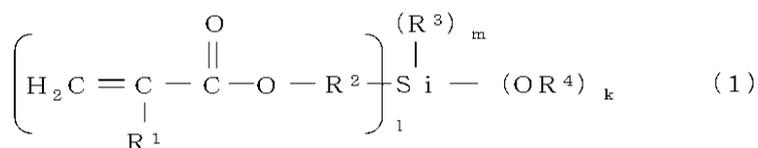
(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物)

本発明においては、下記式(1)

(A)下記式(1)

## 【0031】

## 【化5】



## 【0032】

(式中、

R<sup>1</sup>は、水素原子、またはメチル基であり、R<sup>2</sup>は、炭素数1～20のアルキレン基または炭素数3～10のシクロアルキレン基であり、R<sup>3</sup>は、炭素数1～4のアルキル基、炭素数3～4のシクロアルキル基、または炭素数6～12のアリール基であり、R<sup>4</sup>は、炭素数1～4のアルキル基または炭素数3～4のシクロアルキル基であり、

lは1～3の整数であり、mは0～2の整数であり、kは1～3の整数であり、

l + m + kは4であり、

$R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$  および  $R^4$  がそれぞれ、複数存在する場合には、複数の  $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$  および  $R^4$  は、それぞれ、同種又は異種の基であってもよい)  
で示される(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(以下、単に「(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物」ともいう)(A)を使用する。

【0033】

この(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物を使用することにより、分散性のよい光硬化性ナノインプリント用組成物が得られ、濾過による精製が容易となり生産性が良好となる。また、光硬化により得られる硬化膜の微細な構造において、基材との密着性が良好となる他に、無機成分と有機成分とが比較的均質な状態で分散したものとなる(無機成分が極端に凝集したような分散状態とはならない)。その結果、均一な転写パターン、および均一な残膜を形成することができるものと推定される。

10

【0034】

前記式(1)において、 $R^1$  は水素原子あるいはメチル基である。これらの中でも水素原子のほうが、光硬化性ナノインプリント用組成物を硬化させる際の光硬化速度が速いので好ましい。

【0035】

$R^2$  は、炭素数1~20のアルキレン基又は炭素数3~10のシクロアルキレン基である。具体的には、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、イソプロピレン基、ブチレン基、イソブチレン基、*sec*-ブチレン基、*tert*-ブチレン基、2,2-ジメチルプロピレン基、2-メチルブチレン基、2-メチル-2-ブチレン基、3-メチルブチレン基、3-メチル-2-ブチレン基、ペンチレン基、2-ペンチレン基、3-ペンチレン基、3-ジメチル-2-ブチレン基、3,3-ジメチルブチレン基、3,3-ジメチル-2-ブチレン基、2-エチルブチレン基、ヘキシレン基、2-ヘキシレン基、3-ヘキシレン基、2-メチルペンチレン基、2-メチル-2-ペンチレン基、2-メチル-3-ペンチレン基、3-メチルペンチレン基、3-メチル-2-ペンチレン基、3-メチル-3-ペンチレン基、4-メチルペンチレン基、4-メチル-2-ペンチレン基、2,2-ジメチル-3-ペンチレン基、2,3-ジメチル-3-ペンチレン基、2,4-ジメチル-3-ペンチレン基、4,4-ジメチル-2-ペンチレン基、3-エチル-3-ペンチレン基、ヘブチレン基、2-ヘブチレン基、3-ヘブチレン基、2-メチル-2-ヘキシレン基、2-メチル-3-ヘキシレン基、5-メチルヘキシレン基、5-メチル-2-ヘキシレン基、2-エチルヘキシレン基、6-メチル-2-ヘブチレン基、4-メチル-3-ヘブチレン基、オクチレン基、2-オクチレン基、3-オクチレン基、2-プロピルペンチレン基、2,4,4-トリメチルペンチレン基、デカオクチレン基等のアルキレン基；シクロプロピレン基、シクロブチレン基、シクロプロピルメチレン基、シクロペンチルレン基、シクロヘキシレン基、シクロオクチレン基等のシクロアルキレン基が挙げられる。

20

30

【0036】

これらの中でも、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、イソプロピレン基、ブチレン基等の炭素数1~4のアルキレン基、シクロプロピレン基、シクロブチレン基等の炭素数3~4のシクロアルキレン基が好ましい。

【0037】

$R^3$  は、炭素数1~4のアルキル基、炭素数3~4のシクロアルキル基又は炭素数6~12のアリール基である。具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基等のアルキル基；シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロプロピルメチル基等のシクロアルキル基；フェニル基、ベンジル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、*o*-メチルナフチル基等のアリール基を挙げることができる。中でも、メチル基、エチル基が好ましい。

40

【0038】

$R^4$  は、炭素数1~4のアルキル基又は炭素数3~4のシクロアルキル基である。具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基等のアルキル基；シクロプロピル基、シクロブチ

50

ル基、シクロプロピルメチル基等のシクロアルキル基が挙げられる。

【0039】

この -OR<sup>4</sup> で示されるアルコキシ基は、加水分解時に R<sup>4</sup> 由来のアルコールを生成するが、本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物は、このアルコールを含んでいてもよい。そのため、他成分と容易に混合できるアルコールとなること、および基板上に塗膜を形成した後、容易に除去できるアルコールとなることを考慮すると、具体的には、R<sup>4</sup> は、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の炭素数 1 ~ 4 のアルキル基であることが好ましい。

【0040】

また、l は 1 が好ましく、m は 0 ~ 2 が好ましく、k は 1 ~ 3 が好ましい。ただし、l、m、および k の合計、すなわち、l + m + k は 4 である。

【0041】

このような(メタ)アクリル基含有珪素化合物を具体的に例示すれば、トリメトキシシリルメチレン(メタ)アクリレート、トリメトキシシリルジメチレン(メタ)アクリレート、トリメトキシシリルトリメチレン(メタ)アクリレート、トリエトキシシリルメチレン(メタ)アクリレート、トリエトキシシリルジメチレン(メタ)アクリレート、トリエトキシシリルトリメチレン(メタ)アクリレート、トリプロポキシシリルメチレン(メタ)アクリレート、トリプロポキシシリルジメチレン(メタ)アクリレート、トリプロポキシシリルトリメチレン(メタ)アクリレート、トリイソプロポキシシリルメチレン(メタ)アクリレート、トリイソプロポキシシリルジメチレン(メタ)アクリレート、トリイソプロポキシシリルトリメチレン(メタ)アクリレート、ジメトキシメチルシリルメチレン(メタ)アクリレート、ジメトキシメチルシリルジメチレン(メタ)アクリレート、ジメトキシメチルシリルトリメチレン(メタ)アクリレート、ジエトキシメチルシリルメチレン(メタ)アクリレート、ジエトキシメチルシリルジメチレン(メタ)アクリレート、ジエトキシメチルシリルトリメチレン(メタ)アクリレート、ジメトキシエチルシリルメチレン(メタ)アクリレート、ジメトキシエチルシリルジメチレン(メタ)アクリレート、ジメトキシエチルシリルトリメチレン(メタ)アクリレート、ジエトキシエチルシリルメチレン(メタ)アクリレート、ジエトキシエチルシリルジメチレン(メタ)アクリレート、ジエトキシエチルシリルトリメチレン(メタ)アクリレート、メトキシジメチルシリルメチレン(メタ)アクリレート、メトキシジメチルシリルジメチレン(メタ)アクリレート、メトキシジメチルシリルトリメチレン(メタ)アクリレート、エトキシジメチルシリルメチレン(メタ)アクリレート、エトキシジメチルシリルジメチレン(メタ)アクリレート、エトキシジメチルシリルトリメチレン(メタ)アクリレート、メトキシジエチルシリルメチレン(メタ)アクリレート、メトキシジエチルシリルジメチレン(メタ)アクリレート、メトキシジエチルシリルトリメチレン(メタ)アクリレート、エトキシジエチルシリルメチレン(メタ)アクリレート、エトキシジエチルシリルジメチレン(メタ)アクリレート、エトキシジエチルシリルトリメチレン(メタ)アクリレート等が挙げられる。中でも、トリメトキシシリルトリメチレン(メタ)アクリレート、トリエトキシシリルトリメチレン(メタ)アクリレートが好ましい。

【0042】

(ヘテロポリ酸)

本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物は、ヘテロポリ酸を配合することにより、塩素系ガスに対するエッチング耐性を向上させることができる。前記した通り、特許文献 5 において使用していたジルコニウムアルコキシド等の金属アルコキシドは、エッチング耐性向上効果はあるものの、長期間保存安定性を悪化させる一要因であった。本発明では金属アルコキシドを用いない場合でも、エッチング耐性を良好に保つことが可能であるため、金属アルコキシドを含有させない場合については、塩素系ガスに対するエッチング耐性に優れるという効果に加え長期間保存安定性を良好にすることが可能となる。もちろん

10

20

30

40

50

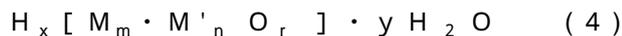
、本発明では、ヘテロポリ酸に加え金属アルコキシドを併用することを除外するものではない。

【0043】

本発明の(B)ヘテロポリ酸とは、ある種のオキソ酸の周りに、別種のオキソ酸が重合した化合物の総称である。また、ヘテロポリ酸は無水物であってもよく、結晶水を含有了水和物であってもよい。なお、本発明では単にヘテロポリ酸と表記した場合は、ヘテロポリ酸の無水物及びヘテロポリ酸の水和物を含む概念であり、同様に例えば、ヘテロポリ酸の下位概念であるケイタングステン酸と表記した場合はケイタングステン酸の無水物及びケイタングステン酸の水和物を含む。

【0044】

本発明では、(B)ヘテロポリ酸は、下記一般式(4)で表される化合物であることが好ましい。



(式中、Mはケイ素、リン、ホウ素より選ばれる一種又は二種の元素から成るヘテロ元素を表し、M'はタングステン、モリブデン、ニオブ、バナジウムより選ばれる一種以上のポリ元素を表し、rは10~100の整数、mは1~10の整数、nは6~40の整数、xは1~10の整数、yは0~50の整数を表す。)

式(4)においてHは水素原子、Oは酸素原子、H<sub>2</sub>Oは水分子を表す。Mはケイ素、リン、ホウ素より選ばれる一種又は二種の元素から成るヘテロ元素を表す。すなわち、mが1であれば、一種のヘテロ元素Mからなるが、mが2以上であれば、一種又は二種のヘテロ元素Mからなる。例えばmが2であれば、2つのMの双方がケイ素であってもよいし、2つのMのうち1つのMがケイ素であり、残りの1つのMがリン、又はホウ素であってもよい。

【0045】

M'はタングステン、モリブデン、ニオブ、バナジウムより選ばれる一種以上のポリ元素を表す。例えばnが12であれば、その12個のM'の全てがタングステンであってもよいし、12個のM'の一部がモリブデン、ニオブ又はバナジウムであってもよい。

【0046】

好適なヘテロポリ酸を例示すれば、ケイタングステン酸、リンタングステン酸、ケイモリブデン酸、リンモリブデン酸、リンモリブドタングステン酸、ケイモリブドタングステン酸、リンバナドタングステン酸、ケイバナドタングステン酸、ケイバナドモリブデン酸、ホウタングステン酸、ホウモリブデン酸、ホウモリブドタングステン酸が好ましい。

【0047】

これらの中でも、ケイタングステン酸が、本発明の組成物の分散性や塩素系ガスに対するエッチング耐性を考慮するとより好ましい。

【0048】

上記式(4)において、xは2~6の整数が好ましく、3又は4がより好ましい。また、mは1~3が好ましく、1がより好ましい。nは8~12の整数が好ましく、12がより好ましい。rは20~60が好ましく、35~45がより好ましく、40が特に好ましい。yは10~40の整数が好ましく、20~30の整数がより好ましい。

【0049】

好ましいヘテロポリ酸を上記式(4)に基づいて、例示すると、H<sub>3</sub>[PW<sub>(n)</sub>Mo<sub>(12-n)</sub>O<sub>40</sub>]yH<sub>2</sub>O、H<sub>3</sub>[PV<sub>(12-n)</sub>W<sub>(n)</sub>O<sub>40</sub>]yH<sub>2</sub>O、H<sub>4</sub>[SiW<sub>(n)</sub>Mo<sub>(12-n)</sub>O<sub>40</sub>]yH<sub>2</sub>O、H<sub>4</sub>[SiV<sub>(12-n)</sub>W<sub>(n)</sub>O<sub>40</sub>]yH<sub>2</sub>O、H<sub>4</sub>[SiW<sub>12</sub>O<sub>40</sub>]yH<sub>2</sub>O(但し、nは8~12以下の整数であり、yは20~30の整数であり、Hは水素原子、Pはリン原子、Siはケイ素原子、Moはモリブデン原子、Vはバナジウム原子、Wはタングステン原子、Oは酸素原子を表す。)で表されるヘテロポリ酸が好ましく、特にH<sub>4</sub>[SiW<sub>12</sub>O<sub>40</sub>]24H<sub>2</sub>Oで表されるケイタングステン酸が好ましい。

【0050】

10

20

30

40

50

特に、 $H_4[SiW_{12}O_{40}]_{24}H_2O$ （別表記は、 $SiO_2 \cdot 12WO_3 \cdot 26H_2O$ ；ケイタングステン酸26水）で表されるケイタングステン酸は、光硬化性ナノインプリント用組成物の分散性や塩素系ガスに対するエッチング耐性を良好にする観点から好ましい。

【0051】

また、本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物の分散性や塩素系ガスに対するエッチング耐性を良好にする観点から、ヘテロポリ酸は、（メタ）アクリル基を有する重合性単量体（C）100質量部に対して、0.1～50質量部とすることが好ましく、0.2～40質量部とすることがより好ましく、1～20質量部にすることが特に好ましい。

【0052】

次に、（メタ）アクリル基を有する重合性単量体（C）について説明する。

（（メタ）アクリル基を有する重合性単量体（C））

本発明において、（メタ）アクリル基を有する重合性単量体（C）（以下、単に「重合性単量体（C）」ともいう）は、特に制限されるものではなく、光重合に使用される公知の（メタ）アクリル基を有する重合性単量体を使用することができる。なお、本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物には、（メタ）アクリル基を有する重合性単量体（C）の他に、本発明の効果を損なわない範囲で、（メタ）アクリル基以外の重合性官能基を有する重合性単量体を含んでいてもよい。この重合性単量体（C）は、前記式（1）で示される（メタ）アクリル基を有する有機珪素化合物を含まない。好ましい化合物としては、（メタ）アクリル基を有し、分子中に珪素原子を含まない重合性単量体が挙げられる。これら重合性単量体（C）は、1分子中に1つの（メタ）アクリル基を有する単官能重合性単量体であってもよいし、1分子中に2つ以上の（メタ）アクリル基を有する多官能重合性単量体であってもよい。さらには、これら単官能重合性単量体および多官能重合性単量体を組み合わせて使用することもできる。

【0053】

重合性単量体（C）の例を具体的に例示すれば、1分子中に1つの（メタ）アクリル基を有する単官能重合性単量体としては、例えば、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、プロピル（メタ）アクリレート、*n*-ブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、*tert*-ブチル（メタ）アクリレート、2-エチルヘキシル（メタ）アクリレート、イソデシル（メタ）アクリレート、イソアミル（メタ）アクリレート、イソミリスチル（メタ）アクリレート、*n*-ラウリル（メタ）アクリレート、*n*-ステアリル（メタ）アクリレート、イソステアリル（メタ）アクリレート、長鎖アルキル（メタ）アクリレート、*n*-ブトキシエチル（メタ）アクリレート、ブトキシジエチレングリコール（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート、ブトキシエチル（メタ）アクリレート、2-エチルヘキシル-ジグリコール（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチル（メタ）アクリレート、ジシクロペンタニル（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、ヒドロキシエチル（メタ）アクリルアミド、2-（2-ビニロキシエトキシ）エチル（メタ）アクリレート、グリシジル（メタ）アクリレート、メトキシエチレングリコール変性（メタ）アクリレート、エトキシエチレングリコール変性（メタ）アクリレート、プロポキシエチレングリコール変性（メタ）アクリレート、メトキシプロピレングリコール変性（メタ）アクリレート、エトキシプロピレングリコール変性（メタ）アクリレート、プロポキシプロピレングリコール変性（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、アダマンタン（メタ）アクリレート誘導体、アクリロイルモルホリン等の脂肪族アクリレート；

ベンジル（メタ）アクリレート、フェノキシメチル（メタ）アクリレート、フェノキシエチル（メタ）アクリレート、フェノキシエチレングリコール変性（メタ）アクリレート、フェノキシプロピレングリコール変性（メタ）アクリレート、ヒドロキシフェノキシエチル

10

20

30

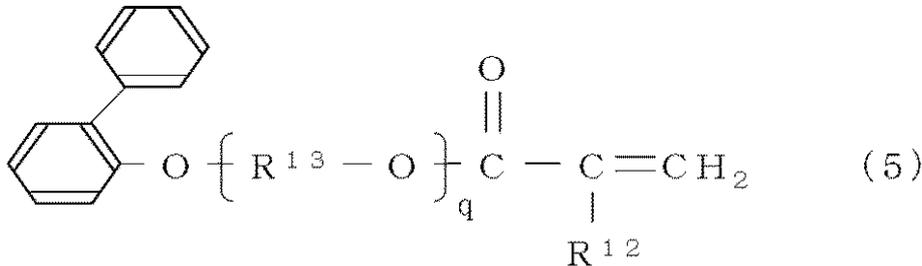
40

50

(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピル(メタ)アクリレート、ヒドロキシキシエチレングリコール変性(メタ)アクリレート、ヒドロキシフェノキシプロピレングリコール変性(メタ)アクリレート、アルキルフェノールエチレングリコール変性(メタ)アクリレート、アルキルフェノールプロピレングリコール変性(メタ)アクリレート、下記式(5)

【0054】

【化6】



10

【0055】

(式中、

$\text{R}^{12}$  は、水素原子、またはメチル基であり、

$\text{R}^{13}$  は、炭素数1~10のアルキレン基または炭素数1~10のヒドロキシアルキレン基であり、 $q$ は1~6の整数である。)で示される分子内に -フェニルフェノール基を有する単量体等の芳香環を有する(メタ)アクリレート等が挙げられる。

20

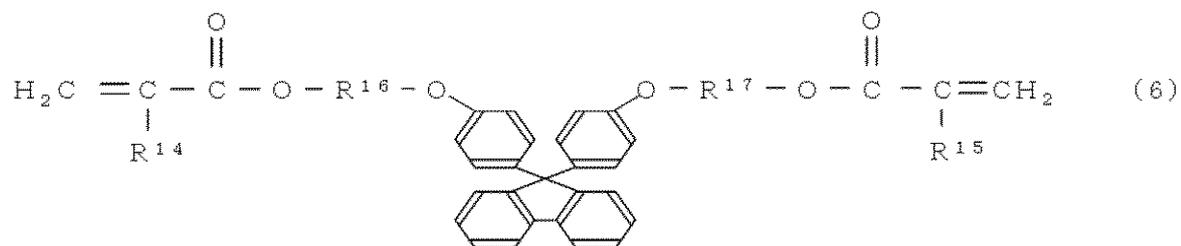
【0056】

1分子中に2つの(メタ)アクリル基を有する多官能重合性単量体(2官能重合性単量体)としては、例えば、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、プロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリオレフィングリコールジ(メタ)アクリレート、エトキシ化ポリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシ-3-アクリロイロキシプロピルメタクリレート、2-ヒドロキシ-1,3-ジメタクリロキシプロパン、ジオキサングリコールジ(メタ)アクリレート、トリシクロデカンジメタノールジ(メタ)アクリレート、1,4-ブタンジオールジ(メタ)アクリレート、グリセリンジ(メタ)アクリレート、1,6-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、1,9-ノナンジオールジ(メタ)アクリレート、1,10-デカンジオールジ(メタ)アクリレート、ネオペンチルグリコールジ(メタ)アクリレート、2-メチル-1,8-オクタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,9-ノナンジオールジ(メタ)アクリレート、ブチルエチルプロパンジオールジ(メタ)アクリレート、3-メチル-1,5-ペンタンジオールジ(メタ)アクリレート等の脂肪族ジ(メタ)アクリレート;エトキシ化ビスフェノールAジ(メタ)アクリレート、プロポキシ化エトキシ化ビスフェノールAジ(メタ)アクリレート、エトキシ化ビスフェノールFジ(メタ)アクリレート、下記式(6)

30

【0057】

【化7】



40

【0058】

(式中、

$\text{R}^{14}$ 、 $\text{R}^{15}$  は、それぞれ独立に水素原子、またはメチル基であり、

50

$R^{16}$ 、 $R^{17}$ は、炭素数1～10のアルキレン基、炭素数1～10のヒドロキシアルキレン基、又は下記式(7)で表される基であり、それぞれ、同種又は異種の基であってもよい。

【0059】

【化8】



10

【0060】

(式中、 $R^{18}$ 及び $R^{19}$ は、エチレン基、またはプロピレン基であり、 $n$ は1～3の整数である。)

で示されるフルオレン構造を有するジ(メタ)アクリレート等の芳香環を有するジ(メタ)アクリレートが挙げられる。

【0061】

さらに、該多官能重合性単量体において、1分子中に3つ以上の(メタ)アクリレート基を有する重合性単量体としては、エトキシ化グリセリントリ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、エトキシ化トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、プロポキシ化トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、ジトリメチロールプロパントテトラ(メタ)アクリレート、エトキシ化ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールポリアクリレートが挙げられる。

20

【0062】

上記重合性単量体(C)の中でも、塩素系ガスのエッチング耐性を向上させることができるという点から、分子内に-フェニルフェノール基を有する単量体、分子内にフルオレン構造を有する単量体が好ましく、前記式(5)で示される分子内に-フェニルフェノール基を有する(メタ)アクリレート、前記式(6)で示されるフルオレン構造を有するジ(メタ)アクリレートが好ましい。

30

【0063】

また、上記重合性単量体(C)は、使用する用途、形成するパターンの形状に応じて、単独でも良いし、複数種類のものを組み合わせて使用しても良い。

【0064】

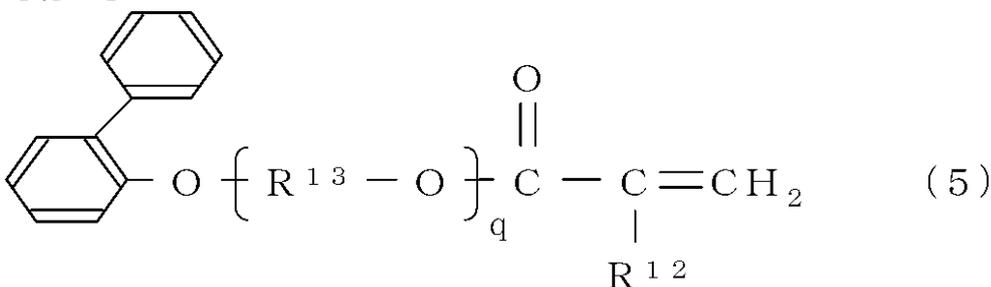
式(5)で示される分子内に-フェニルフェノール基を有する(メタ)アクリレートについて説明する。

【0065】

下記式(5)

【0066】

【化9】



40

【0067】

(式中、

50

$R^{12}$  は、水素原子、またはメチル基であり、

$R^{13}$  は、炭素数 1 ~ 10 のアルキレン基または炭素数 1 ~ 10 のヒドロキシアルキレン基であり、 $q$  は 1 ~ 6 の整数である。) )

において、 $R^{12}$  は水素原子あるいはメチル基である。これらの中でも水素原子のほうが、光硬化性ナノインプリント用組成物を硬化させる際の光硬化速度が速いので好ましい。

【 0 0 6 8 】

$R^{13}$  は、炭素数 1 ~ 10 のアルキレン基または炭素数 1 ~ 10 のヒドロキシアルキレン基である。具体的には、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、イソプロピレン基、ブチレン基、イソブチレン基、*sec*-ブチレン基、*tert*-ブチレン基、2, 2-ジメチルプロピレン基、2-メチルブチレン基、2-メチル-2-ブチレン基、3-メチルブチレン基、3-メチル-2-ブチレン基、ペンチレン基、2-ペンチレン基、3-ペンチレン基、3-ジメチル-2-ブチレン基、3, 3-ジメチルブチレン基、3, 3-ジメチル-2-ブチレン基、2-エチルブチレン基、ヘキシレン基、2-ヘキシレン基、3-ヘキシレン基、2-メチルペンチレン基、2-メチル-2-ペンチレン基、2-メチル-3-ペンチレン基、3-メチルペンチレン基、3-メチル-2-ペンチレン基、3-メチル-3-ペンチレン基、4-メチルペンチレン基、4-メチル-2-ペンチレン基、2, 2-ジメチル-3-ペンチレン基、2, 3-ジメチル-3-ペンチレン基、2, 4-ジメチル-3-ペンチレン基、4, 4-ジメチル-2-ペンチレン基、3-エチル-3-ペンチレン基、ヘブチレン基、2-ヘブチレン基、3-ヘブチレン基、2-メチル-2-ヘキシレン基、2-メチル-3-ヘキシレン基、5-メチルヘキシレン基、5-メチル-2-ヘキシレン基、2-エチルヘキシレン基、6-メチル-2-ヘブチレン基、4-メチル-3-ヘブチレン基、オクチレン基、2-オクチレン基、3-オクチレン基、2-プロピルペンチレン基、2, 4, 4-トリメチルペンチレン基等のアルキレン基；1-ヒドロキシエチレン基、2-ヒドロキシエチレン基、1-ヒドロキシプロピレン基、2-ヒドロキシプロピレン基、3-ヒドロキシプロピレン基、1-ヒドロキシイソプロピレン基、2-ヒドロキシイソプロピレン基、3-ヒドロキシイソプロピレン基、1-ヒドロキシブチレン基、2-ヒドロキシブチレン基、3-ヒドロキシブチレン基、4-ヒドロキシブチレン基、1-ヒドロキシイソブチレン基、2-ヒドロキシイソブチレン基、3-ヒドロキシイソブチレン基、1-ヒドロキシ*sec*-ブチレン基、2-ヒドロキシ*sec*-ブチレン基、3-ヒドロキシ*sec*-ブチレン基、4-ヒドロキシ*sec*-ブチレン基、1-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロピレン基、3-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロピレン基、1-ヒドロキシ-2-メチルブチレン基、2-ヒドロキシ-2-メチルブチレン基、3-ヒドロキシ-2-メチルブチレン基、4-ヒドロキシ-2-メチルブチレン基、1-ヒドロキシ2-メチル-2-ブチレン基、3-ヒドロキシ2-メチル-2-ブチレン基、4-ヒドロキシ2-メチル-2-ブチレン基、1-ヒドロキシ-3-メチルブチレン基、2-ヒドロキシ-3-メチルブチレン基、3-ヒドロキシ-3-メチルブチレン基、4-ヒドロキシ-3-メチルブチレン基、1-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブチレン基、2-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブチレン基、3-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブチレン基、4-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブチレン基、1-ヒドロキシペンチレン基、2-ヒドロキシペンチレン基、3-ヒドロキシペンチレン基、4-ヒドロキシペンチレン基、5-ヒドロキシペンチレン基、1-ヒドロキシ-2-ペンチレン基、2-ヒドロキシ-2-ペンチレン基、3-ヒドロキシ-2-ペンチレン基、4-ヒドロキシ-2-ペンチレン基、5-ヒドロキシ-2-ペンチレン基、1-ヒドロキシ-3-ペンチレン基、2-ヒドロキシ-3-ペンチレン基、3-ヒドロキシ-3-ペンチレン基、4-ヒドロキシ-3-ペンチレン基、5-ヒドロキシ-3-ペンチレン基、1-ヒドロキシ-3-ジメチル-2-ブチレン基、2-ヒドロキシ-3-ジメチル-2-ブチレン基、3-ヒドロキシ-3-ジメチル-2-ブチレン基、4-ヒドロキシ-3-ジメチル-2-ブチレン基、1-ヒドロキシ-3, 3-ジメチルブチレン基、2-ヒドロキシ-3, 3-ジメチルブチレン基、4-ヒドロキシ-3, 3-ジメチルブチレン基、1-ヒドロキシ-3, 3-ジメチル-2-





シアロキレン基が好ましい。

【0070】

式(5)で示される分子内に - フェニルフェノール基を有する(メタ)アクリレートとして、例えば、3 - - フェニルフェノールメチル(メタ)アクリレート、3 - - フェニルフェノールエチル(メタ)アクリレート、3 - - フェニルフェノールプロピル(メタ)アクリレート、3 - - フェニルフェノールブチル(メタ)アクリレート、3 - - フェニルフェノールジエトキシ(メタ)アクリレート、3 - - フェニルフェノールトリエトキシ(メタ)アクリレート、3 - - フェニルフェノールテトラエトキシ(メタ)アクリレート、2 - ヒドロキシ - 3 - - フェニルフェノールプロピル(メタ)アクリレート、2 - ヒドロキシ - 3 - - フェニルフェノールブチル(メタ)アクリレート、3 - ヒドロキシ - 3 - - フェニルフェノールプロピル(メタ)アクリレート等が挙げられる。

10

【0071】

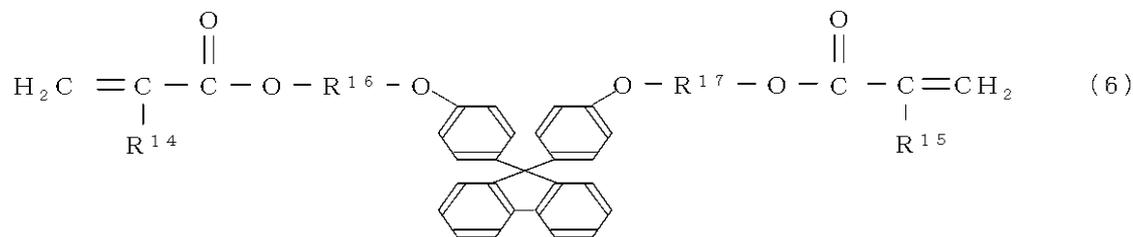
式(6)で示される分子内にフルオレン構造を有するジ(メタ)アクリレートについて説明する。

【0072】

下記式(6)

【0073】

【化10】



20

【0074】

(式中、

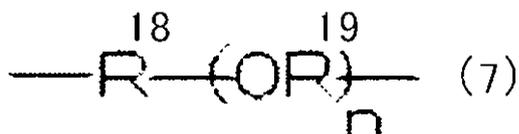
R<sup>14</sup>、R<sup>15</sup>は、それぞれ独立に水素原子、またはメチル基であり、

R<sup>16</sup>、R<sup>17</sup>は、炭素数1~10のアルキレン基、炭素数1~10のヒドロキシアルキレン基、又は下記式(7)で表される基であり、それぞれ、同種又は異種の基であってもよい。)

30

【0075】

【化11】



【0076】

(式中、R<sup>18</sup>及びR<sup>19</sup>は、エチレン基、またはプロピレン基であり、nは1~3の整数である。)

40

において、R<sup>14</sup>、R<sup>15</sup>はそれぞれ独立に水素原子あるいはメチル基である。これらの中でも水素原子のほうが、光硬化性ナノインプリント用組成物を硬化させる際の光硬化速度が速いので好ましい。

【0077】

R<sup>16</sup>、R<sup>17</sup>は、炭素数1~10のアルキレン基、炭素数1~10のヒドロキシアルキレン基、又は式(7)で表される基である。具体的には、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、イソプロピレン基、ブチレン基、イソブチレン基、sec-ブチレン基、tert-ブチレン基、2,2-ジメチルプロピレン基、2-メチルブチレン基、2-メチ

50

ル - 2 - ブチレン基、3 - メチルブチレン基、3 - メチル - 2 - ブチレン基、ペンチレン基、2 - ペンチレン基、3 - ペンチレン基、3 - ジメチル - 2 - ブチレン基、3, 3 - ジメチルブチレン基、3, 3 - ジメチル - 2 - ブチレン基、2 - エチルブチレン基、ヘキシレン基、2 - ヘキシレン基、3 - ヘキシレン基、2 - メチルペンチレン基、2 - メチル - 2 - ペンチレン基、2 - メチル - 3 - ペンチレン基、3 - メチルペンチレン基、3 - メチル - 2 - ペンチレン基、3 - メチル - 3 - ペンチレン基、4 - メチルペンチレン基、4 - メチル - 2 - ペンチレン基、2, 2 - ジメチル - 3 - ペンチレン基、2, 3 - ジメチル - 3 - ペンチレン基、2, 4 - ジメチル - 3 - ペンチレン基、4, 4 - ジメチル - 2 - ペンチレン基、3 - エチル - 3 - ペンチレン基、ヘプチレン基、2 - ヘプチレン基、3 - ヘプチレン基、2 - メチル - 2 - ヘキシレン基、2 - メチル - 3 - ヘキシレン基、5 - メチルヘキシレン基、5 - メチル - 2 - ヘキシレン基、2 - エチルヘキシレン基、6 - メチル - 2 - ヘプチレン基、4 - メチル - 3 - ヘプチレン基、オクチレン基、2 - オクチレン基、3 - オクチレン基、2 - プロピルペンチレン基、2, 4, 4 - トリメチルペンチレン基等のアルキレン基；トリメチレン基、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基、ヘプタメチレン基、オクタメチレン基、ノナメチレン基、デカメチレン基等のポリメチレン基、1 - ヒドロキシエチレン基、2 - ヒドロキシエチレン基、1 - ヒドロキシプロピレン基、2 - ヒドロキシプロピレン基、3 - ヒドロキシプロピレン基、1 - ヒドロキシイソプロピレン基、2 - ヒドロキシイソプロピレン基、3 - ヒドロキシイソプロピレン基、1 - ヒドロキシブチレン基、2 - ヒドロキシブチレン基、3 - ヒドロキシブチレン基、4 - ヒドロキシブチレン基、1 - ヒドロキシイソブチレン基、2 - ヒドロキシイソブチレン基、3 - ヒドロキシイソブチレン基、1 - ヒドロキシ sec - ブチレン基、2 - ヒドロキシ sec - ブチレン基、3 - ヒドロキシ sec - ブチレン基、4 - ヒドロキシ sec - ブチレン基、1 - ヒドロキシ - 2, 2 - ジメチルプロピレン基、3 - ヒドロキシ - 2, 2 - ジメチルプロピレン基、1 - ヒドロキシ - 2 - メチルブチレン基、2 - ヒドロキシ - 2 - メチルブチレン基、3 - ヒドロキシ - 2 - メチルブチレン基、4 - ヒドロキシ - 2 - メチルブチレン基、1 - ヒドロキシ 2 - メチル - 2 - ブチレン基、3 - ヒドロキシ 2 - メチル - 2 - ブチレン基、4 - ヒドロキシ 2 - メチル - 2 - ブチレン基、1 - ヒドロキシ - 3 - メチルブチレン基、2 - ヒドロキシ - 3 - メチルブチレン基、3 - ヒドロキシ - 3 - メチルブチレン基、4 - ヒドロキシ - 3 - メチルブチレン基、1 - ヒドロキシ - 3 - メチル - 2 - ブチレン基、2 - ヒドロキシ - 3 - メチル - 2 - ブチレン基、3 - ヒドロキシ - 3 - メチル - 2 - ブチレン基、4 - ヒドロキシ - 3 - メチル - 2 - ブチレン基、1 - ヒドロキシペンチレン基、2 - ヒドロキシペンチレン基、3 - ヒドロキシペンチレン基、4 - ヒドロキシペンチレン基、5 - ヒドロキシペンチレン基、1 - ヒドロキシ - 2 - ペンチレン基、2 - ヒドロキシ - 2 - ペンチレン基、3 - ヒドロキシ - 2 - ペンチレン基、4 - ヒドロキシ - 2 - ペンチレン基、5 - ヒドロキシ - 2 - ペンチレン基、1 - ヒドロキシ - 3 - ペンチレン基、2 - ヒドロキシ - 3 - ペンチレン基、3 - ヒドロキシ - 3 - ペンチレン基、4 - ヒドロキシ - 3 - ペンチレン基、5 - ヒドロキシ - 3 - ペンチレン基、1 - ヒドロキシ - 3 - ジメチル - 2 - ブチレン基、2 - ヒドロキシ - 3 - ジメチル - 2 - ブチレン基、3 - ヒドロキシ - 3 - ジメチル - 2 - ブチレン基、4 - ヒドロキシ - 3 - ジメチル - 2 - ブチレン基、1 - ヒドロキシ - 3, 3 - ジメチルブチレン基、2 - ヒドロキシ - 3, 3 - ジメチルブチレン基、4 - ヒドロキシ - 3, 3 - ジメチルブチレン基、1 - ヒドロキシ - 3, 3 - ジメチル - 2 - ブチレン基、2 - ヒドロキシ - 3, 3 - ジメチル - 2 - ブチレン基、4 - ヒドロキシ - 3, 3 - ジメチル - 2 - ブチレン基、1 - ヒドロキシ - 2 - エチルブチレン基、2 - ヒドロキシ - 2 - エチルブチレン基、3 - ヒドロキシ - 2 - エチルブチレン基、4 - ヒドロキシ - 2 - エチルブチレン基、1 - ヒドロキシ - ヘキシレン基、2 - ヒドロキシ - ヘキシレン基、3 - ヒドロキシ - ヘキシレン基、4 - ヒドロキシ - ヘキシレン基、5 - ヒドロキシ - ヘキシレン基、6 - ヒドロキシ - ヘキシレン基、1 - ヒドロキシ - 2 - ヘキシレン基、2 - ヒドロキシ - 2 - ヘキシレン基、3 - ヒドロキシ - 2 - ヘキシレン基、4 - ヒドロキシ - 2 - ヘキシレン基、5 - ヒドロキシ - 2 - ヘキシレン基、6 - ヒドロキシ - 2 - ヘキシレン基、1 - ヒドロキシ - 3 - ヘキシレン基、2 - ヒドロキシ

10

20

30

40

50



- ヘキシレン基、4 - ヒドロキシ - 2 - メチル - 3 - ヘキシレン基、5 - ヒドロキシ - 2 - メチル - 3 - ヘキシレン基、6 - ヒドロキシ - 2 - メチル - 3 - ヘキシレン基、1 - ヒドロキシ - 5 - メチルヘキシレン基、2 - ヒドロキシ - 5 - メチルヘキシレン基、3 - ヒドロキシ - 5 - メチルヘキシレン基、4 - ヒドロキシ - 5 - メチルヘキシレン基、5 - ヒドロキシ - 5 - メチルヘキシレン基、6 - ヒドロキシ - 5 - メチルヘキシレン基、1 - ヒドロキシ - 5 - メチル - 2 - ヘキシレン基、2 - ヒドロキシ - 5 - メチル - 2 - ヘキシレン基、3 - ヒドロキシ - 5 - メチル - 2 - ヘキシレン基、4 - ヒドロキシ - 5 - メチル - 2 - ヘキシレン基、5 - ヒドロキシ - 5 - メチル - 2 - ヘキシレン基、6 - ヒドロキシ - 5 - メチル - 2 - ヘキシレン基、1 - ヒドロキシ - 2 - エチルヘキシレン基、2 - ヒドロキシ - 2 - エチルヘキシレン基、3 - ヒドロキシ - 2 - エチルヘキシレン基、4 - ヒドロキシ - 2 - エチルヘキシレン基、5 - ヒドロキシ - 2 - エチルヘキシレン基、6 - ヒドロキシ - 2 - エチルヘキシレン基、1 - ヒドロキシ - 6 - メチル - 2 - ヘプチレン基、2 - ヒドロキシ - 6 - メチル - 2 - ヘプチレン基、3 - ヒドロキシ - 6 - メチル - 2 - ヘプチレン基、4 - ヒドロキシ - 6 - メチル - 2 - ヘプチレン基、5 - ヒドロキシ - 6 - メチル - 2 - ヘプチレン基、6 - ヒドロキシ - 6 - メチル - 2 - ヘプチレン基、7 - ヒドロキシ - 6 - メチル - 2 - ヘプチレン基、1 - ヒドロキシ - 4 - メチル - 3 - ヘプチレン基、2 - ヒドロキシ - 4 - メチル - 3 - ヘプチレン基、3 - ヒドロキシ - 4 - メチル - 3 - ヘプチレン基、4 - ヒドロキシ - 4 - メチル - 3 - ヘプチレン基、5 - ヒドロキシ - 4 - メチル - 3 - ヘプチレン基、6 - ヒドロキシ - 4 - メチル - 3 - ヘプチレン基、1 - ヒドロキシシオクチレン基、2 - ヒドロキシシオクチレン基、3 - ヒドロキシシオクチレン基、4 - ヒドロキシシオクチレン基、5 - ヒドロキシシオクチレン基、6 - ヒドロキシシオクチレン基、7 - ヒドロキシシオクチレン基、8 - ヒドロキシシオクチレン基、1 - ヒドロキシ - 2 - オクチレン基、2 - ヒドロキシ - 2 - オクチレン基、3 - ヒドロキシ - 2 - オクチレン基、4 - ヒドロキシ - 2 - オクチレン基、5 - ヒドロキシ - 2 - オクチレン基、6 - ヒドロキシ - 2 - オクチレン基、7 - ヒドロキシ - 2 - オクチレン基、8 - ヒドロキシ - 2 - オクチレン基、1 - ヒドロキシ - 3 - オクチレン基、2 - ヒドロキシ - 3 - オクチレン基、3 - ヒドロキシ - 3 - オクチレン基、4 - ヒドロキシ - 3 - オクチレン基、5 - ヒドロキシ - 3 - オクチレン基、6 - ヒドロキシ - 3 - オクチレン基、7 - ヒドロキシ - 3 - オクチレン基、8 - ヒドロキシ - 3 - オクチレン基、1 - ヒドロキシ - 2 - プロピルペンチレン基、2 - ヒドロキシ - 2 - プロピルペンチレン基、3 - ヒドロキシ - 2 - プロピルペンチレン基、4 - ヒドロキシ - 2 - プロピルペンチレン基、5 - ヒドロキシ - 2 - プロピルペンチレン基、1 - ヒドロキシ - 2, 4, 4 - トリメチルペンチレン基、2 - ヒドロキシ - 2, 4, 4 - トリメチルペンチレン基、3 - ヒドロキシ - 2, 4, 4 - トリメチルペンチレン基、5 - ヒドロキシ - 2, 4, 4 - トリメチルペンチレン基等のヒドロキシアルキレン基等、エチレングリコール基、ジエチレングリコール基、トリエチレングリコール基、テトラエチレングリコール基、ペンタエチレングリコール基等のポリエチレングリコール基、プロピレングリコール基、ジプロピレングリコール基、トリプロピレングリコール基、テトラプロピレングリコール基等のポリプロピレングリコール基が挙げられる。

【0078】

これらの中でも、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、イソプロピレン基、ブチレン基等の炭素数1~4のアルキレン基又は、1 - ヒドロキシエチレン基、2 - ヒドロキシエチレン基、1 - ヒドロキシプロピレン基、2 - ヒドロキシプロピレン基、3 - ヒドロキシプロピレン基、1 - ヒドロキシイソプロピレン基、2 - ヒドロキシイソプロピレン基、3 - ヒドロキシイソプロピレン基、1 - ヒドロキシブチレン基、2 - ヒドロキシブチレン基、3 - ヒドロキシブチレン基、4 - ヒドロキシブチレン基、1 - ヒドロキシイソブチレン基等の炭素数1~4のヒドロキシアルキレン基、又は、式(7)において $R^{18}$ 、 $R^{19}$ がエチレン基であり、かつnが1~2の基、または $R^{18}$ 、 $R^{19}$ がプロピレン基であり、かつnが1~2の基が好ましい。

式(6)で示される分子内にフルオレン構造を有するジ(メタ)アクリレートとして、例

えは、9, 9 - ビス [ 4 - ( 2 - ( メタ ) アクリロイルオキシメトキシ ) フェニル ] フルオレン、9, 9 - ビス [ 4 - ( 2 - ( メタ ) アクリロイルオキシエトキシ ) フェニル ] フルオレン、9, 9 - ビス [ 4 - ( 2 - ( メタ ) アクリロイルオキシプロピルオキシ ) フェニル ] フルオレン、9, 9 - ビス [ 4 - ( 2 - ( メタ ) アクリロイルオキシイソプロピルオキシ ) フェニル ] フルオレン、9, 9 - ビス [ 4 - ( 2 - ( メタ ) アクリロイルオキシブチルオキシ ) フェニル ] フルオレン、9, 9 - ビス [ 4 - ( 2 - ( メタ ) アクリロイルオキシヒドロキシエチルエトキシ ) フェニル ] フルオレン、9, 9 - ビス [ 4 - ( 2 - ( メタ ) アクリロイルオキシヒドロキシプロピルオキシ ) フェニル ] フルオレン、9, 9 - ビス [ 4 - ( 2 - ( メタ ) アクリロイルオキシヒドロキシイソプロピルオキシ ) フェニル ] フルオレン、9, 9 - ビス [ 4 - ( 2 - ( メタ ) アクリロイルオキシヒドロキシブチルオキシ ) フェニル ] フルオレン、9, 9 - ビス [ 4 - ( 2 - ( メタ ) アクリロイルオキシエチレングリコキシ ) フェニル ] フルオレン、9, 9 - ビス [ 4 - ( 2 - ( メタ ) アクリロイルオキシプロピレングリコキシ ) フェニル ] フルオレン等が挙げられる。

【 0 0 7 9 】

次に、光重合開始剤 ( D ) について説明する。

【 0 0 8 0 】

( 光重合開始剤 ( D ) )

本発明において、光重合開始剤 ( D ) は特に制限されるものではなく、重合性単量体 ( C ) を光重合できるものであれば、いかなる光重合開始剤も使用できる。

【 0 0 8 1 】

光重合開始剤としては、具体的に、2, 2 - ジメトキシ - 1, 2 - ジフェニルエタン - 1 - オン、1 - ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、2 - ヒドロキシ - 2 - メチル - 1 - フェニルプロパン - 1 - オン、1 - [ 4 - ( 2 - ヒドロキシエトキシ ) - フェニル ] - 2 - ヒドロキシ - 2 - メチル - 1 - プロパン - 1 - オン、2 - ヒドロキシ - 1 - { 4 - [ 4 - ( 2 - ヒドロキシ - 2 - メチルプロピオニル ) - ベンジル ] - フェニル } - 2 - メチル - プロパン - 1 - オン、フェニルグリオキシリックアシッドメチルエステル、2 - メチル - 1 - [ 4 - ( メチルチオ ) フェニル ] - 2 - モルフォリノプロパン - 1 - オン、2 - ベンジル - 2 - ジメチルアミノ - 1 - ( 4 - モルフォリノフェニル ) - ブタノン - 1, 2 - ジメチルアミノ - 2 - ( 4 - メチルベンジル ) - 1 - ( 4 - モリフォリン - 4 - イル - フェニル ) ブタン - 1 - オン等のアセトフェノン誘導体；2, 4, 6 - トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド、2, 6 - ジメトキシベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド、2, 6 - ジクロロベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド、2, 6 - トリメチルベンゾイルフェニルホスフィン酸メチルエステル、2 - メチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド、ピバロイルフェニルホスフィン酸イソプロピルエステル、ビス - ( 2, 6 - ジクロロベンゾイル ) フェニルホスフィンオキサイド、ビス - ( 2, 6 - ジクロロベンゾイル ) - 2, 5 - ジメチルフェニルホスフィンオキサイド、ビス - ( 2, 6 - ジクロロベンゾイル ) - 4 - プロピルフェニルホスフィンオキサイド、ビス - ( 2, 6 - ジクロロベンゾイル ) - 1 - ナフチルホスフィンオキサイド、ビス - ( 2, 6 - ジメトキシベンゾイル ) フェニルホスフィンオキサイド、ビス - ( 2, 6 - ジメトキシベンゾイル ) - 2, 4, 4 - トリメチルペンチルホスフィンオキサイド、ビス - ( 2, 6 - ジメトキシベンゾイル ) - 2, 5 - ジメチルフェニルホスフィンオキサイド、ビス - ( 2, 4, 6 - トリメチルベンゾイル ) フェニルホスフィンオキサイド、ビス - ( 2, 5, 6 - トリメチルベンゾイル ) - 2, 4, 4 - トリメチルペンチルホスフィンオキサイド等のアシルホスフィンオキサイド誘導体；1, 2 - オクタンジオン、1 - [ 4 - ( フェニルチオ ) - , 2 - ( 0 - ベンゾイルオキシム ) ]、エタノン、1 - [ 9 - エチル - 6 - ( 2 - メチルベンゾイル ) - 9 H - カルバゾール - 3 - イル ] - , 1 - ( 0 - アセチルオキシム ) 等の 0 - アシルオキシム誘導体；ジアセチル、アセチルベンゾイル、ベンジル、2, 3 - ペンタジオン、2, 3 - オクタジオン、4, 4' - ジメトキシベンジル、4, 4' - オキシベンジル、カンファーキノ、9, 10 - フェナンスレンキノ、アセナフテンキノ等の - ジケトン；ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインプロピルエーテル等のベンゾインアル

10

20

30

40

50

キルエーテル；2,4-ジエトキシチオキサソソ、2-クロロチオキサソソ、メチルチオキサソソ等のチオキサソソ誘導体；ベンゾフェノン、p, p'-ジメチルアミノベンゾフェノン、p, p'-メトキシベンゾフェノン等のベンゾフェノン誘導体；ビス(5-2,4-シクロペンタジエン-1-イル)-ビス(2,6-ジフルオロ-3-(1H-ピロール-1-イル)-フェニル)チタニウム等のチタノセン誘導体が好適に使用される。

## 【0082】

これら光重合開始剤は、1種あるいは2種以上を混合して使用される。

## 【0083】

また、 $\alpha$ -ジケトンを用いる場合には、第3級アミン化合物と組み合わせて用いることが好ましい。 $\alpha$ -ジケトンと組み合わせて用いることのできる第3級アミン化合物としては、N,N-ジメチルアニリン、N,N-ジエチルアニリン、N,N-ジ-n-ブチルアニリン、N,N-ジベンジルアニリン、N,N-ジメチル-p-トルイジン、N,N-ジエチル-p-トルイジン、N,N-ジメチル-m-トルイジン、p-ブromo-N,N-ジメチルアニリン、m-クロロ-N,N-ジメチルアニリン、p-ジメチルアミノベンズアルデヒド、p-ジメチルアミノアセトフェノン、p-ジメチルアミノ安息香酸、p-ジメチルアミノ安息香酸エチルエステル、p-ジメチルアミノ安息香酸アミルエステル、N,N-ジメチルアンスラニリックアシッドメチルエステル、N,N-ジヒドロキシエチルアニリン、N,N-ジヒドロキシエチル-p-トルイジン、p-ジメチルアミノフェネチルアルコール、p-ジメチルアミノスチルベン、N,N-ジメチル-3,5-キシリジン、4-ジメチルアミノピリジン、N,N-ジメチル-p-ナフチルアミン、N,N-ジメチル-m-ナフチルアミン、トリブチルアミン、トリプロピルアミン、トリエチルアミン、N-メチルジエタノールアミン、N-エチルジエタノールアミン、N,N-ジメチルヘキシルアミン、N,N-ジメチルドデシルアミン、N,N-ジメチルステアリルアミン、N,N-ジメチルアミノエチルメタクリレート、N,N-ジエチルアミノエチルメタクリレート、2,2'-(n-ブチイミノ)ジエタノール等が挙げられる。

10

20

## 【0084】

本発明においては、アセトフェノン誘導体、アシルホスフィンオキサイド誘導体、O-アシルオキシム誘導体、 $\alpha$ -ジケトンを使用することが好ましい。

## 【0085】

本発明において、上記光重合開始剤の使用量は、前記重合性単量体(C)100質量部に対して、0.1~10質量部であることが好ましく、0.1~5質量部であることがエッチング耐性の観点からより好ましい。

30

## 【0086】

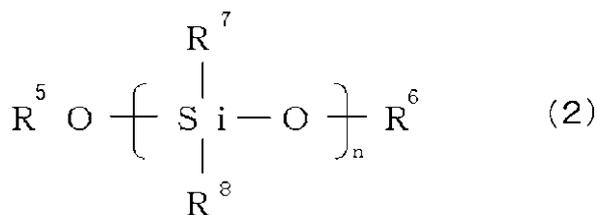
(有機珪素化合物)

本発明においては、下記式(2)

(E)下記式(2)

## 【0087】

## 【化12】



40

## 【0088】

(式中、

R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>は同種又は異種の炭素数1~4のアルキル基または水素であり、

50

R<sup>7</sup> はアリアル基であり、R<sup>8</sup> はアリアル基または炭素数 1 ~ 4 のアルコキシ基であり、n は 1 ~ 10 の整数である。) で示される有機珪素化合物 (以下、単に「有機珪素化合物」ともいう) (E) を含有することが好ましく、この有機珪素化合物を使用することにより、塩素系ガス、酸素系ガス、フッ素系ガス等に対するエッチング耐性が向上し、特に塩素系ガスに対するエッチング耐性を向上させることができる。

【0089】

本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物は、水の有無は特に制限されない。水を配合しない場合は、長期間保存安定性の点で効果があるが、若干ではあるが転写性が劣る場合がある。しかしながら、水を加えない場合でも、前記式(2)の有機珪素化合物を用いることにより、転写性を改善することが可能となる。

10

【0090】

前記式(2)において、R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>は、水素、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、sec-ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基が挙げられ、中でも、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基が好ましい。本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物は、アルコールを含んでいてもよい。そのため、他成分と容易に混合できるアルコールとなること、および基板上に塗膜を形成した後、容易に除去できるアルコールとなることを考慮すると、具体的には、R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>は、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の炭素数 1 ~ 4 のアルキル基であることが好ましい。

【0091】

R<sup>7</sup>、R<sup>8</sup> は、アリアル基としては、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基等のアリアル基を挙げることができ、中でもフェニル基が好ましい。

20

【0092】

また、R<sup>8</sup> は、アルコキシ基としては、メチルアルコキシ基、エチルアルコキシ基、プロピルアルコキシ基、イソプロピルアルコキシ基、ブチルアルコキシ基、sec-ブチルアルコキシ基、イソブチルアルコキシ基、tert-ブチルアルコキシ基等を挙げることができる。アルコキシ基としては、中でもメチルアルコキシ基、エチルアルコキシ基、プロピルアルコキシ基、イソプロピルアルコキシ基、ブチルアルコキシ基が好ましい。このR<sup>8</sup> で示されるアルコキシ基は、他成分と容易に混合できるアルコールとなること、および基板上に塗膜を形成した後、容易に除去できるアルコールとなることを考慮すると、具体的には、メチルアルコキシ基、エチルアルコキシ基、プロピルアルコキシ基、イソプロピルアルコキシ基、ブチルアルコキシ基、sec-ブチルアルコキシ基、イソブチルアルコキシ基、tert-ブチルアルコキシ基等の炭素数 1 ~ 4 のアルコキシ基であることが好ましい。該アリアル基及びアルコキシ基は、アルキル基、エーテル基、グリコールエーテル基、水酸基、ハロゲン等の置換基を有していても良い。

30

【0093】

なかでも、R<sup>7</sup>、R<sup>8</sup> はアリアル基であることがエッチング耐性、特に塩素系ガスのエッチング耐性が良好な硬化膜を形成する点で好ましい。

【0094】

また、該有機珪素化合物は、前記式(2)において、n が 1 ~ 10 の整数を満足するものであれば、単一の化合物であってもよいし、n の値が異なる複数の有機珪素化合物の混合物であってもよい。単一の化合物を使用する場合、n の値は、より比較的低い圧力でのパターンの転写性や、100nm以下などの微細パターンの転写を勘案すると、1以上7以下であることが好ましい。また、複数の有機珪素化合物の混合物を使用する場合、n の平均値は、1以上10以下となることが好ましく、さらには、より比較的低い圧力でのパターンの転写性や、100nm以下などの微細パターンの転写を勘案すると、1以上7以下がより好ましい。

40

【0095】

これら有機珪素化合物を具体的に例示すれば、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニルトリプロポキシシラン、フェニルトリブトキシシラン、ジ

50

フェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン、ジフェニルジプロポキシシラン、ジフェニルジブトキシシラン、およびそれらの重縮合物が挙げられる。中でも、加水分解時に生成するアルコールが、塗膜を形成した後、容易に除去できるアルコールであることや、反応性等の理由から、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン、およびそれらの重縮合物が好ましい。

【0096】

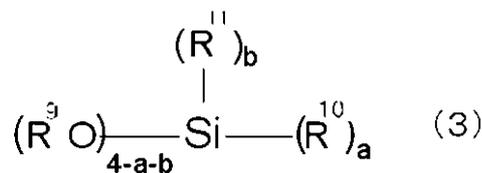
(フッ素化有機シラン化合物)

本発明においては、下記式(3)

(F) 下記式(3)

【0097】

【化13】



【0098】

(式中、

R<sup>9</sup>、およびR<sup>11</sup>は、それぞれ、炭素数1~10のアルキル基、または炭素数3~10のシクロアルキル基であり；R<sup>10</sup>は、炭素数1~100の含フッ素アルキル基、含フッ素シクロアルキル基、または含フッ素アルコキシエーテル基であり；aは1~3の整数であり、bは、0~2の整数であり、ただし、a+b=1~3であり；R<sup>9</sup>、R<sup>10</sup>およびR<sup>11</sup>がそれぞれ複数存在する場合には、複数のR<sup>9</sup>、R<sup>10</sup>およびR<sup>11</sup>は、それぞれ同一であっても、異なる基であってもよい。)で示されるフッ素化有機シラン化合物(以下、単に「フッ素化有機シラン化合物」ともいう)(F)をさらに含むことができる。このフッ素化有機シラン化合物を使用することにより、パターン基板との密着性を損わずに金型からの離型性を向上することができる。

【0099】

前記式(3)において、R<sup>9</sup>およびR<sup>11</sup>は、炭素数1~10のアルキル基、または炭素数3~10のシクロアルキル基であり、好ましくは、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、sec-ブチル基、イソブチル基、ter-ブチル基等の炭素数1~4のアルキル基が挙げられる。前記式(3)の-O R<sup>9</sup>からなるアルコキシ基は、他成分と容易に混合できるアルコールとなることを考慮すると、具体的には、R<sup>9</sup>は、メチル基、エチル基、プロピル基であることがより好ましい。

R<sup>10</sup>は、含フッ素アルキル基、含フッ素シクロアルキル基、または含フッ素アルコキシエーテル基である。ここで含フッ素アルキル基とは、アルキル基の1又は2以上の水素原子をフッ素原子に置換したものを意味し、その他の含フッ素シクロアルキル基、または含フッ素アルコキシエーテル基も同様にそれぞれシクロアルキル基、アルコキシエーテル基の1又は2以上の水素原子をフッ素原子に置換したものを意味する。含フッ素アルキル基の炭素数は1~10が好ましく、含フッ素シクロアルキル基の炭素数は3~10が好ましい。また、本発明における含フッ素アルコキシエーテル基は、下記式(8)で表されるアルコキシエーテル基において1又は2以上の水素原子をフッ素原子に置換したものである。

【0100】

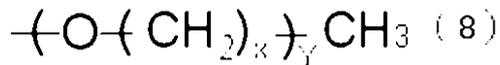
10

20

30

40

## 【化 1 4】



## 【0101】

(式中、Xは1以上の整数であり、Yは2以上の整数である)

上記式(8)において、Xは1~6、Yは5~50が好ましい。

また、R<sup>9</sup>、R<sup>10</sup>、およびR<sup>11</sup>がそれぞれ複数存在する場合には、その複数のR<sup>9</sup>、R<sup>10</sup>、およびR<sup>11</sup>は、同一であっても、異なる基であってもよい。

10

## 【0102】

これらフッ素化有機シラン化合物を具体的に例示すれば、(ヘプタデカフルオロ-1, 1, 2, 2-テトラヒドロデシル)-トリエトキシシラン、(ヘプタデカフルオロ-1, 1, 2, 2-テトラヒドロデシル)-トリメトキシシラン、ノナフルオロヘキシルトリエトキシシラン、ノナフルオロヘキシルトリメトキシシラン、(トリデカフルオロ-1, 1, 2, 2-テトラヒドロオクチル)-トリエトキシシラン、(トリデカフルオロ-1, 1, 2, 2-テトラヒドロオクチル)-トリメトキシシラン、ペンタフルオロ-1, 1, 2, 2-テトラヒドロペンチルトリエトキシシラン、ペンタフルオロ-1, 1, 2, 2-テトラヒドロペンチルトリメトキシシラン、(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)ジメチルエトキシシラン、(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)ジメチルメトキシシラン、(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)メチルジエトキシシラン、(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)トリエトキシシラン、(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)トリメトキシシラン、パーフルオロプロピルトリエトキシシラン、パーフルオロプロピルトリメトキシシラン、5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-トリデカフルオロ-2-(トリデカフルオロヘキシル)デシルトリエトキシシラン、5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-トリデカフルオロ-2-(トリデカフルオロヘキシル)デシルトリメトキシシラン、パーフルオロドデシル-1H, 1H, 2H, 2H-トリエトキシシラン、パーフルオロドデシル-1H, 1H, 2H, 2H-トリメトキシシラン、パーフルオロテトラデシル-1H, 1H, 2H, 2H-トリエトキシシラン、パーフルオロテトラデシル-1H, 1H, 2H, 2H-トリメトキシシラン、3-(パーフルオロシクロヘキシルオキシ)プロピルトリメトキシシラン等が挙げられ、上記式(8)で表されるアルコキシエーテル基において1又は2以上の水素原子をフッ素原子に置換した含フッ素アルコキシエーテル基を有するフッ素化有機シラン化合物の例としては、商品名としては、例えば、ダイキン工業株式会社製オプツールHD-1100THが挙げられる。これらの中でも、分子同士の相互作用が比較的弱く分子配列構造の乱れから表面剥離性に有利と思われる点や前記式(3)の-O R<sup>9</sup>からなるアルコキシ基の加水分解のし易さを考慮すると、(トリデカフルオロ-1, 1, 2, 2-テトラヒドロオクチル)-トリメトキシシラン、(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)トリメトキシシランが好ましい。

20

30

## 【0103】

(光硬化性ナノインプリント用組成物の製造方法)

本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物は、前記(A)~(D)成分、及びこれらに加えて、必要に応じて(E)、(F)成分、その他添加剤等を混合してなるものである。

40

## 【0104】

本発明において、光硬化性ナノインプリント用組成物を構成する前記(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)と前記ヘテロポリ酸(B)は、以下の配合量とすることが好ましい。つまり、光硬化性ナノインプリント用組成物は、重合性単量体(C)100質量部に対して、前記(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)3~300質量部、前記ヘテロポリ酸(B)0.1~50質量部、及び前記光重合開始剤(D)0.1~

50

10 質量部を含むことが好ましい。

【0105】

(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)とヘテロポリ酸(B)の配合量が前記範囲を満足することにより、分散性が良く、塗膜外観の良好な光硬化性ナノインプリント用組成物となり、濾過による精製が容易で生産性を向上することができる。さらに、塩素エッチング耐性、基材密着性が特に良好となる。また、比較的低下でのナノインプリントが可能となるため、使用するモールドの寿命を長くすることもできる。分散性や比較的低下でのナノインプリントを考慮すると、重合性単量体(C)100質量部に対して、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)の配合量は、5~250質量部であることがより好ましく、ヘテロポリ酸(B)の配合量は、0.2~40質量部であることがより好ましい。

10

【0106】

さらには、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物の配合量(A)は、8~200質量部であることが特に好ましく、ヘテロポリ酸(B)の配合量は、0.5~30質量部であることが特に好ましい。(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)の配合量は、10~180質量部であることが最も好ましく、ヘテロポリ酸(B)の配合量は、1~20質量部であることが最も好ましい。

【0107】

本発明において、光硬化性ナノインプリント用組成物を構成する前記(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)と前記ヘテロポリ酸(B)にさらに、有機珪素化合物(E)を含むことができる。有機珪素化合物(E)を含むことで、エッチング耐性、特に塩素系ガスに対するエッチング耐性を向上させることができる。

20

有機珪素化合物(E)の使用量は、下記に詳述する重合性単量体(C)100質量部に対して有機珪素化合物(E)を10~400質量部とするのが好ましい。

下記に詳述する重合性単量体(C)100質量部に対して、有機珪素化合物(E)の使用量は、20~350質量部であることがより好ましく、さらには、有機珪素化合物(E)の使用量は、30~300質量部であることが特に好ましく、有機珪素化合物(E)の使用量は40~250質量部であることが最も好ましい。

【0108】

本発明において、光硬化性ナノインプリント用組成物を構成する前記(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)と前記ヘテロポリ酸(B)にさらに、フッ素化有機シラン化合物(F)を含むことができる。フッ素化有機シラン化合物(F)を含むことで、パターンの基板との密着性を損なわずに金型からの離型性を向上することができる。フッ素化有機シラン化合物(F)の使用量は、下記に詳述する重合性単量体(B)100質量部に対して、フッ素化有機シラン化合物(F)0.001~4質量部とすることが好ましい。

30

下記に詳述する重合性単量体(B)100質量部に対して、フッ素化有機シラン化合物(F)の使用量は、0.01~3質量部であることがより好ましく、さらには、フッ素化有機シラン化合物(F)の使用量は、0.03~2質量部であることが特に好ましく、フッ素化有機シラン化合物(F)の使用量は0.05~1質量部であることが最も好ましい。

40

【0109】

(光硬化性ナノインプリント用組成物の製造方法：使用する水、およびその量)

本発明では、光硬化性ナノインプリント用組成物を構成する(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)、さらに、有機珪素化合物(E)、および/または、フッ素化有機シラン化合物(F)は、加水分解の有無は特に制限されないが、ヘテロポリ酸の組成物中での溶解性や、転写性の観点から、加水分解により、アルコキシ基の一部が部分的に加水分解された状態が好ましい。

【0110】

加水分解に新たに添加する水の量は、長期保存安定性を考慮すると一定の量にすることが好ましい。すなわち、添加する水の量は、全アルコキシ基のモル数に対して、0倍モル

50

以上 2.0 倍モル未満から好ましく選択でき、より好ましくは、全アルコキシ基のモル数に対して、0 倍モル以上 1.2 倍モル未満である。なお、全アルコキシ基のモル数とは、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)の使用モル数と該(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)1分子中に存在するアルコキシ基の数との積と、有機珪素化合物(E)を使用する場合には、有機珪素化合物(E)の使用モル数と該有機珪素化合物(E)1分子中に存在するアルコキシ基の数との積、フッ素化有機シラン化合物(F)を使用する場合には、フッ素化有機シラン化合物(F)の使用モル数と該フッ素化有機シラン化合物1分子中に存在するアルコキシ基の数との積を加えたものである。

#### 【0111】

本発明において、ヘテロポリ酸(B)が加水分解で使用される酸となるが、ヘテロポリ酸(B)の他にも酸を使用してもよい。使用する酸としては、塩酸、硝酸、硫酸、リン酸、ポリリン酸等の無機酸、有機リン酸、蟻酸、酢酸、無水酢酸、クロロ酢酸、プロピオン酸、酪酸、吉草酸、クエン酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、乳酸、フマル酸、リンゴ酸、イタコン酸、シュウ酸、ムチン酸、尿酸、バルビツル酸、p-トルエンスルホン酸等の有機酸、酸性陽イオン交換樹脂が挙げられる。酸を使用する場合には、特に制限されるものではないが、その使用量は、全アルコキシ基のモル数に対して、水素イオンが 0.0001 倍モル以上 0.01 倍モル以下となる量とすることが好ましい。また、この酸はそのまま使用することもできるが、酸水溶液、又は水に分散させた状態のものを使用することが好ましい。この場合、0.1 ~ 6 N の濃度のものを使用することが好ましい。この場合、使用した水は、上記水の使用量に含まれるものとする。

10

20

#### 【0112】

本発明において、光硬化性ナノインプリント用組成物は、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)(有機珪素化合物(E)および/またはフッ素化有機シラン化合物(F)を用いる場合は有機珪素化合物(E)および/フッ素化有機シラン化合物(F)も含む)とポリヘテロ酸とを混合する。

ポリヘテロ酸以外の酸や水を添加する場合の方法としては、例えば、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)に所定量の酸や水を添加し加水分解することや、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)と有機珪素化合物(E)の混合物に所定量の酸や水を添加し加水分解することや、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)と有機珪素化合物(E)とフッ素化有機シラン化合物(F)の混合物に所定量の酸や水を添加し加水分解することや、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)とフッ素化有機シラン化合物(F)の混合物に所定量の水や酸を添加し加水分解した後、さらに、有機珪素化合物(E)を添加し、所定量の酸や水を添加し加水分解することが挙げられる。

30

#### 【0113】

また、加水分解させる成分と水との混合は、5 以上 60 以下の温度にて実施すればよい。この際、加水分解を容易に進行させるため、希釈溶媒を使用することもできる。希釈溶媒としては、炭素数 1 ~ 4 のアルコールが好ましく、特に、エタノールを使用することが好ましい。希釈溶媒の使用量は、加水分解させる成分の種類により適宜決定すればよいが、加水分解させる成分の混合物 100 質量部に対して、50 ~ 400 質量部であることが好ましい。

40

#### 【0114】

(光硬化性ナノインプリント用組成物の製造方法：加水分解条件)

本発明において、加水分解における反応温度は、特に制限されないが、通常は、5 ~ 60 の範囲から選択される。反応時間は、前記反応温度との兼ね合いで適宜選択すれば良く、通常は、10分 ~ 12時間の範囲から選択される。

#### 【0115】

(光硬化性ナノインプリント用組成物の使用方法、物性)

上記の方法に従い、光硬化性ナノインプリント用組成物を準備することができる。加水分解時にアルコキシ基に由来するアルコールを生じる。本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物は、加水分解時に副生するアルコール及び加水分解に使用した水を含むことも

50

できる。さらには、加水分解を容易に進めるために使用した希釈溶媒を含むこともできる。

【0116】

光硬化性ナノインプリント用組成物は、他の成分との混合のし易さ、光硬化性ナノインプリント用組成物の生産性等を考慮すると、25における粘度が0.1~100 mPa・secであることが好ましい。なお、この粘度の値は、音叉式粘度計：AND VIBRO VISC O METER SV-1Aにより測定した値であり、副生したアルコール、使用した水、および希釈のために使用した希釈溶媒を含む状態で用いる場合には、これらを含んだものを測定した際の値である。

【0117】

(光硬化性ナノインプリント用組成物におけるその他の添加成分)

本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物には、本発明の効果を阻害しない範囲でその他の成分を配合することができる。

【0118】

本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物の使用に当たり、前記光硬化性ナノインプリント用組成物を基板上に塗布して使用するが、この場合、光硬化性ナノインプリント用組成物を溶媒で希釈して使用することもできる。また、本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物を安定化させる目的、又は、その他の目的で溶媒や安定剤やその他公知の添加剤を配合することもできる。使用される溶媒としては、本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物が溶解する溶媒であれば、何ら制限なく使用でき、例えば、アセトニトリル、テトラヒドロフラン、トルエン、クロロホルム、酢酸エチルエステル、メチルエチルケトン、ジメチルホルムアミド、シクロヘキサノン、エチレングリコール、エチレングリコールイソプロピルエーテル、プロピレングリコール、プロピレングリコールメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、メチル-3-メトキシプロピオネート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチルラクテート、エチル-3-エトキシプロピオネート、ブチルアセテート、2-ヘプタノン、メチルイソブチルケトン、ジアセトンアルコール、アセチルアセトン、*t*-ブチルアルコール、ポリエチレングリコール、その他のアルコール類を挙げることができる。溶媒を使用する場合、使用量は特に制限されず、目的の塗膜の厚みに応じて、適宜選択される。中でも、溶媒および光硬化性ナノインプリント用組成物の合計量を100質量%とすると、該溶媒の濃度が10~99質量%となる範囲とすることが好ましい。

【0119】

使用される安定化剤としては、ゾルゲル成分の安定化剤として一般的に知られているものであれば、何ら制限なく使用でき、例えば、メトキシ酢酸などのヒドロキシカルボン酸アルキルエーテル；グリコール酸、乳酸、シュウ酸、マンデル酸、2-ヒドロキシイソ酪酸などのヒドロキシカルボン酸；ジエタノールアミンなどのエタノールアミン類；ジアセチル、2,5-ヘキサジオン、アセチルアセトン、メチルプロピルジケトン、ジメドンなどのジケトン類が挙げられる。安定剤を使用する場合、使用量は特に制限されないが、ゾルゲル成分量に応じて、使用量を調節することが好ましい。

【0120】

本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物には、その他の公知の添加剤を配合することができる。具体的には、界面活性剤、重合禁止剤、反応性希釈剤等を配合することができる。界面活性剤は塗膜の均一性の点から、重合禁止剤は保存中に重合しないように安定化させるために配合される。

【0121】

界面活性剤を配合する場合には、重合性単量体(C)100質量部に対して、0.0001~0.1質量部、好ましくは、0.0005~0.01質量部の割合で配合することができる。

【0122】

界面活性剤としては、フッ素含有界面活性剤、シリコーン含有界面活性剤、脂肪族系

10

20

30

40

50

面活性剤を使用できる。中でも、光硬化性ナノインプリント用組成物がシリコンウエハ等の基板へ塗布されるものの場合、はじきを生ずることなく、組成物を均一に塗布し易い点から、脂肪族系界面活性剤を使用することがより好ましい。

界面活性剤の例としては、デシル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム等の高級アルコール硫酸エステル金属塩類、ラウリン酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム、オレイン酸ナトリウム等の脂肪族カルボン酸金属塩類、ラウリルアルコールとエチレンオキシドとの付加物を硫酸化したラウリルエーテル硫酸エステルナトリウム等の高級アルキルエーテル硫酸エステル金属塩類、スルホコハク酸ナトリウム等のスルホコハク酸ジエステル類、高級アルコールエチレンオキシド付加物のリン酸エステル塩類等のアニオン性活性剤；ドデシルアンモニウムクロリド等のアルキルアミン塩類およびトリメチルドデシルアンモニウムブロミド等の4級アンモニウム塩類等のカチオン性界面活性剤；ドデシルジメチルアミンオキシド等のアルキルジメチルアミンオキシド類、ドデシルカルボキシベタイン等のアルキルカルボキシベタイン類、ドデシルスルホベタイン等のアルキルスルホベタイン類、ラウラミドプロピルアミンオキシド等のアミドアミノ酸塩等の両性イオン界面活性剤；ポリオキシエチレンラウリルエーテル等のポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレンジスチレン化フェニルエーテル類、ポリオキシエチレンラウリルフェニルエーテル等のポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル類、ポリオキシエチレントリベンジルフェニルエーテル類、脂肪酸ポリオキシエチレンラウリルエステル等の脂肪酸ポリオキシエチレンエステル類、ポリオキシエチレンソルビタンラウリルエステル等のポリオキシエチレンソルビタンエステル類等の非イオン性界面活性剤等を挙げることができる。界面活性剤は、それぞれ単独で使用できるだけでなく、必要に応じて、複数の種類を組み合わせ併用することもできる。

10

20

30

40

50

#### 【0123】

重合禁止剤を配合する場合には、重合性単量体(C)100質量部に対して、0.01~1.0質量部、好ましくは、0.1~0.5質量部の割合で配合することができる。

#### 【0124】

重合禁止剤の例としては、公知のものを挙げることができ、例えば、最も代表的なものは、ヒドロキノンモノメチルエーテル、ヒドロキノン、ブチルヒドロキシトルエン等を挙げることができる。

#### 【0125】

反応性希釈剤としては、N-ビニルピロリドン等の公知のものを挙げることができる。

#### 【0126】

反応性希釈剤の添加量は特に制限されず、金型からのパターンの形成に影響を及ぼさない範囲で適宜選択され、重合性単量体(C)100質量部に対して、通常、1~100質量部の範囲から適宜選択される。その中でも、光硬化性ナノインプリント用組成物の低粘度化、パターンの機械的強度等を勘案すると、5~50質量部であることが好ましい。

#### 【0127】

また、他の添加成分として、金型(パターン形成面)からの剥離性がよりよくなり、これにより、基板上に、再現性に優れた形状のパターンを形成できることから、パイパーブランチポリマーのような球状微粒子を添加することもできる。この場合、直径は1~10nm、分子量10,000~100,000の球状ハイパーブランチポリマーを配合することが好ましい。配合量は、重合性単量体(C)100質量部に対して0.1~10質量部の量であることが好ましい。

#### 【0128】

本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物は、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)、ヘテロポリ酸(B)、重合性単量体(C)、光重合開始剤(D)、必要に応じて配合する有機珪素化合物(E)、必要に応じて配合するフッ素化有機シラン化合物(F)、その他の添加成分を混合することにより得られてなるものである。これら成分の添加順序は特に制限されるものではない。

## 【0129】

次に、この光硬化性ナノインプリント用組成物を使用して、基板上にパターンを形成する方法について説明する。

## 【0130】

(光硬化性インプリン用組成物を用いたパターンの形成法)

本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物を用いたパターン形成方法について説明する。

## 【0131】

先ず、上記方法に従って調製した光硬化性ナノインプリント用組成物を、基材上に公知の方法に従って塗布することにより、塗膜を形成する。

## 【0132】

該基材としては、特にその形態、材質は制限されるものではなく、基板、シート、フィルム状のものが使用できる。具体的には、シリコンウエハ、石英、ガラス、サファイア、各種金属材料、アルミナ・窒化アルミニウム・炭化珪素・窒化珪素等のセラミックス、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリカーボネートフィルム、トリアセチルセルロースフィルム、シクロオレフィン樹脂フィルムのような公知の基板、シート、フィルムを使用することができる。なお、これら基材は、本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物よりなる硬化膜との密着性をより改善するために、表面処理を施すこともできる。

## 【0133】

これら基材上に、スピンコート法、ディッピング法、ディスペンス法、インクジェット法、スプレーコート法、ロールtoロール法のような公知の方法により、本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物を塗布し、乾燥することによって、塗膜を形成すればよい。塗膜の厚みは、特に制限されるものではなく、目的とする用途に応じて適宜決定すればよいが、通常0.1~5 $\mu$ mであり、本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物は、0.01~0.1 $\mu$ mの厚みの塗膜の形成にも好適に適用できる。

## 【0134】

乾燥温度は、塗膜が乾燥する温度として、適宜決定すれば良く、通常は40~150の範囲から選択できる。薄く塗布するためには、本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物を有機溶媒にて希釈して塗布することも可能であり、その場合は、用いる有機溶媒の沸点、揮発性に依りて、乾燥温度を適宜決定すればよい。

## 【0135】

次に、所望のパターンが形成されている金型のパターン形成面を、前記塗膜と接触させる。この際、金型は、光照射を介して、塗布された組成物を硬化させることにより硬化膜を形成できるように、透明な材質、例えば、石英や透明な樹脂フィルムで形成されていることが好ましい。本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物は、金型を押し付ける際に比較的低压でパターンを転写することができる。この際の圧力は、特に制限されるものではないが、0.01MPa~1MPaの圧力でパターンを転写できる。なお、当然のことながら、上記圧力の上限值以上の圧力でもパターンの転写は可能である。

## 【0136】

その後、金型のパターン形成面と塗膜とを接触させた状態のまま、光を照射して、塗膜を硬化させる。照射する光は、波長が500nm以下で、光の照射時間は、0.1~300秒の範囲から選択される。塗膜の厚み等にもよるが、通常、1~60秒である。

## 【0137】

光重合時の雰囲気として、大気下でも重合可能であるが、光重合反応を促進する上で、酸素阻害の少ない雰囲気下での光重合が好ましい。例えば、窒素ガス雰囲気下、不活性ガス雰囲気下、フッ素系ガス雰囲気下、真空雰囲気下等が好ましい。

## 【0138】

光硬化後、硬化した塗膜から金型を分離することにより、基板上に硬化した塗膜(硬化膜)によりパターンが形成された積層体を得られる。

10

20

30

40

50

## 【0139】

(基板へのパターン形成：硬化膜によりパターンを形成した積層体のエッチング)

本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物は、形成される硬化膜が優れたエッチング耐性を示す。そのため、該硬化膜より形成されるパターンは、酸素ガス、フッ素系ガス、塩素系ガス等によるエッチング耐性が非常に良好となり、酸素ガス、フッ素系ガス、塩素系ガス等によるエッチングによってナノスケールの凹凸構造を有する基材を製造する際のマスクとして好適に用いることができる。特に、本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物から得られる硬化膜は、サファイア基板を加工するための塩素系ガスに対するエッチング耐性に優れていることから、サファイア基板を表面加工する際のマスクとして用いるのに適している。なお、塩素系ガスとしては、反応性イオンエッチングに用いられる公知のガスを使用することができる。具体的には、塩素、三塩化ホウ素、四塩化炭素を挙げることができ、必要に応じて、酸素ガス、フッ素系ガス等を混合して使用することもできる。

10

## 【0140】

上記したようにして得た、金型にてパターンを転写した硬化膜を表面に有する基板(硬化膜によりパターンを形成した積層体)に、硬化膜のパターンに基づくパターンを形成する方法としては、先ず、硬化膜の肉薄部分(残膜)をドライエッチングにより除去し、基板表面を出す。さらに、残膜を除去した部分の基板のドライエッチングを行う。硬化膜の肉厚部分により覆われた基板は硬化膜の肉厚部分がマスクとなり全てはドライエッチングされない。最後に残った硬化膜の肉厚部分を除去することにより、基板表面をドライエッチング加工した基板を得ることができる。硬化膜の肉厚部分の除去方法としては、ドライエッチングや、ウェットエッチングによって除去することができ、なかでもサファイア基板へのパターン形成の場合、フッ素系ガスによるドライエッチングが好適に用いられる。硬化膜の肉薄部分(残膜)をドライエッチングにより除去した後、残膜を除去した部分の基板表面に金属を蒸着することもできる。

20

## 【0141】

サファイア基板表面を加工することにより、LEDの光取り出し効率の向上や結晶転移の少ない均質なGaN成長やGaN層のクラック防止が期待される。

## 【0142】

(硬化膜によりパターンを形成した積層体の使用(レプリカ金型として使用))

上記方法によりエッチングすることにより基板にパターンを形成できるが、本発明の光硬化性ナノインプリント用組成物は、優れた性能を有するため、その他の用途にも使用できる。例えば、該光硬化性ナノインプリント用組成物よりなる硬化膜は、無機成分の分散状態がよいため、優れた硬度を有する。そのため、基板上に硬化膜よりなるパターンが形成された積層体は、ナノインプリント用のレプリカ金型として使用することもできる。

30

## 【0143】

このナノインプリント用レプリカ金型として使用する場合には、上記積層体の表面に、フッ素を含有するシランカップリング剤を反応させることが好ましい。該シランカップリング剤を反応させることにより、積層体表面と他物質との離型性を向上させることができる。該硬化膜には、アルコキシ基が残存していると考えられ、化学的に該シランカップリング剤と結合できるものと考えられる。そのため、該シランカップリング剤を反応させて得られる積層体は、より一層、離型性の優れたものとなる。

40

## 【0144】

該シランカップリング剤は、離型性を向上できるフッ素原子を含有するシランカップリング剤であれば、公知のものを使用できる。具体的には、トリハロゲン化有機シラン分子やトリアルコキシ有機シラン分子のアルキル鎖の水素の一部ないし全部をフッ素に置換したものが挙げられる。

## 【0145】

該シランカップリング剤と該積層体との反応は、特に制限されるものではないが、加湿条件下で行うことが好ましい。具体的には、相対湿度40~100%の条件下で反応させ

50

ることが好ましい。上記湿度下でシランカップリング剤と積層体とを接触させることにより、両者を反応させることができる。反応させる際の温度は、特に制限されるものではないが、40～80であることが好ましい。また、接触させる方法は、液状のシランカップリング剤においては、パターンが形成された面を液に浸漬させたり、ディップコート、スピンコート、スプレートート等、公知の方法にて表面に塗布すればよい。反応させる際の時間は、温度と相対湿度により適宜選択することができる。

#### 【0146】

このような方法により該シランカップリング剤と反応させた積層体は、ハイドロフルオロエーテル等のフッ素系溶剤やアルコール等により洗浄した後、乾燥すればよい。得られた積層体は、離型性能の優れたものとなり、ナノインプリント用レプリカ金型として使用

10

#### 【実施例】

#### 【0147】

以下、本発明を実施例および比較例を掲げて説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

#### 【0148】

##### (1) 硬化膜の基板密着性の評価

得られた光硬化性ナノインプリント用組成物をアセチルアセトンにて希釈して、サファイア基板（片鏡面、厚さ430 $\mu$ m、表面粗さRa 0.1nm、面方位C面）上に、3000rpm、30秒間でスピンコートし、120において2分間乾燥した後、UV照射して、厚み約1 $\mu$ mの光硬化性ナノインプリント用組成物による硬化膜を作製し、ニチバン（株）製15mm幅セロハンテープ405を用い（長さ5cm）、指圧にて3往復密着させたのち剥離して、

20

硬化膜が全く剥がれなかったもの	: 5
剥離面積が10%未満のもの	: 4
剥離面積が10%以上50%未満のもの	: 3
剥離面積が50%以上100%未満のもの	: 2
剥離面積が100%（全面剥離）のもの	: 1

として評価した。

#### 【0149】

##### (2) 金型との離型性評価

得られた光硬化性ナノインプリント用組成物をアセチルアセトンにて希釈して、シリコンウエハ（P型、片鏡面、酸化膜なし）上に、3000rpm、30秒間でスピンコートし、120において2分間乾燥して、厚み約1 $\mu$ mの光硬化性ナノインプリント用組成物の塗膜がコーティングされたシリコンウエハを得た。金型として縦20mm・横20mmの平面形状の石英板を用い、ナノインプリント装置（三明電子産業（株）製、ImpFlex Essential）において、上記で得られたシリコンウエハに、圧力0.25MPaをかけLED光源365nmの光を10秒間照射して光インプリントを行った。硬化膜から石英板を引き剥がす際の応力（離型力）を測定し、金型との離型性を評価した。

30

#### 【0150】

##### (3) 転写性の評価

##### (光硬化性ナノインプリント用組成物の塗布)

得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を、アセチルアセトンにて希釈し、希釈した光硬化性ナノインプリント用組成物を、シリコンウエハ（P型、片鏡面、酸化膜なし）上に、3000rpm、30秒間でスピンコートし、120において2分間乾燥して、光硬化性ナノインプリント用組成物の塗膜が約1 $\mu$ mの厚みでコーティングしたシリコンウエハを得た。

40

#### 【0151】

##### (パターンの形成：積層体の製造)

200nmライン/スペースの石英モールドを用い、ナノインプリント装置（三明電子産

50

業（株）製、ImpFlex-Essential）において、上記のようにして得られた光硬化性ナノインプリント用組成物の塗膜を有するシリコンウエハに、圧力1MPaをかけLED365nm光源から光を10秒間照射して、光ナノインプリントを行った。なお、用いた石英モールドは、あらかじめフッ素系表面処理（ダイキン工業（株）製、オプツールHD-1100TH）で離型処理を施した。

#### 【0152】

走査型電子顕微鏡（SEM）観察により、光硬化性ナノインプリント用組成物を用いてサファイア基板上に形成したパターン形状の転写性を評価した。転写性の評価は、計100本の幅200nmラインが全て転写できているものを「○」とし、一部にパターン形状の不良が見られるものを「△」とし、全てのパターンが転写できていないものを「×」として評価した。

10

#### 【0153】

（4）エッチング耐性の評価

（サファイア基板のエッチング）

サファイア基板（片鏡面、厚さ430μm、表面粗さRa 0.1nm、面方位C面）を反応性イオンエッチング装置を用いて、以下の条件にて塩素ガスによるドライエッチングを行い、一定時間でのエッチング量（サファイア基板の減少厚み）を段差測定器で測定した。

<塩素ガスによるドライエッチング条件>

塩素ガス流量：20sccm

アンテナパワー：400W

バイアスパワー：80W

基板冷却温度：5

20

#### 【0154】

（硬化膜のエッチング）

得られた光硬化性ナノインプリント用組成物をアセチルアセトンにて希釈して、シリコンウエハ（P型、片鏡面、酸化膜なし）上に、3000rpm、30秒間でスピコートし、120℃において2分間乾燥した後、UV照射して、厚み約1μmの光硬化性ナノインプリント用組成物の硬化膜でコーティングしたシリコンウエハを得た。得られた硬化膜でコーティングしたシリコンウエハを、サファイア基板の塩素ガスによるドライエッチングと同じ条件にてドライエッチングを行い、一定時間での硬化膜の減少した塗膜厚みを段差測定器で測定した。

30

#### 【0155】

（サファイア選択比の算出）

サファイア基板のみでのサファイア基板の一定時間でのエッチング量（サファイア基板の減少厚み）と光硬化性ナノインプリント用組成物の硬化膜の一定時間での硬化膜の減少した塗膜厚みとの比（サファイア基板の一定時間でのエッチング量（サファイア基板の減少厚み）/光硬化性ナノインプリント用組成物の硬化膜の一定時間での硬化膜の減少した塗膜厚み）を算出し、これを光硬化性ナノインプリント用組成物の硬化膜のサファイア選択比とした。サファイア選択比の値が高いほど、光硬化性ナノインプリント用組成物による硬化膜はサファイア基板と比較して、塩素ガスによるエッチングを受け難く、サファイア基板を用いた場合における塩素エッチング耐性が良いことになる。

40

#### 【0156】

（5）長期間保存安定性の評価

得られた光硬化性ナノインプリント用組成物をサンプル瓶に入れて蓋で密封し、50℃に保った恒温オープン中に入れて、長期間保存安定性の評価を行った。

連続21日間以上、流動性や外観（沈殿、透明性）に変化が見られなかったものを「○」とし、8日～20日で流動性や外観（沈殿、透明性）に変化が見られたものを「△」とし、0日～7日で流動性や外観（沈殿、透明性）に変化が見られたものを「×」とした。

#### 【0157】

50

(6) 使用した化合物とその略称

メタアクリル基を有する有機珪素化合物 (A)

トリメトキシシリルトリメチレンアクリレート; KBM-5103

ヘテロポリ酸 (B)

$H_4[SiW_{12}O_{40}] \cdot 24H_2O$  (別表記は、 $SiO_2 \cdot 12WO_3 \cdot 26H_2O$ ; ケイタングステン酸 26 水)

(メタ)アクリル基を有する重合性単量体 (C)

ヒドロキシエチル化 o-フェニルフェノールアクリレート; A-LEN-10

9,9-ビス[4-(2-アクリロイルオキシエトキシ)フェニル]フルオレン; A-BPEF

10

ポリエチレングリコールジアクリレート; A-200

トリメチロールプロパントリアクリレート; A-TMPT

トリシクロデカンジメタノールジアクリレート; A-DCP

光重合開始剤 (D)

2-ジメチルアミノ-2-(4-メチル-ベンジル)-1-(4-モルフォリン-4-イル-フェニル)-ブタン-1-オン; 379EG

有機珪素化合物 (E)

ジフェニルジメトキシシラン; DPDMs

ジフェニルシランジオール; DPSDO

トリメトキシフェニルシラン; TMPS

20

テトラエトキシシラン; TEOS

フッ素化有機シラン化合物 (F)

(3,3,3-トリフルオロプロピル)トリメトキシシラン; TFPS

金属アルコキシド

ジルコニウムブトキシド

【0158】

実施例 1

(光硬化性ナノインプリント用組成物の製造)

窒素ガスで置換したグローブボックス内で、エタノール 9.6 g、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物 (A) としてトリメトキシシリルトリメチレンアクリレート (信越化学工業 (株) 製 KBM-5103) 1.5 g、ヘテロポリ酸 (B) としてケイタングステン酸 26 水 (和光純薬工業製) 0.5 g とを混合した。この混合物を大気雰囲気、室温下 1 時間攪拌し、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物 (A) とヘテロポリ酸 (B) の混合物を得た。

30

【0159】

(メタ)アクリル基を有する重合性単量体 (C) として、ヒドロキシエチル化 o-フェニルフェノールアクリレート (新中村化学工業 (株) 製、NKエステル A-LEN-10) 5.0 g、9,9-ビス[4-(2-アクリロイルオキシエトキシ)フェニル]フルオレン (新中村化学工業 (株) 製、NKエステル A-BPEF) 5.0 g を使用した。

40

【0160】

光重合開始剤 (D) として、2-ジメチルアミノ-2-(4-メチル-ベンジル)-1-(4-モルフォリン-4-イル-フェニル)-ブタン-1-オン (BASF ジャパン (株) 製、IRGACURE (登録商標) 379 EG) 0.2 g を使用した。

【0161】

重合禁止剤として、ヒドロキノンモノメチルエーテル 0.015 g、ブチルヒドロキシトルエン 0.002 g を使用した。

【0162】

上記 (メタ)アクリル基を有する重合性単量体 (C) と光重合開始剤 (D) と重合禁止剤とを均一に混合し、その混合物を 1.0 g 分取した。該混合物 1.0 g に、前記 (メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物 (A) とヘテロポリ酸 (B) の混合物 1.0 g とア

50

セチルアセトン 2.5 g を添加し、室温で 15 分間攪拌することにより光硬化性ナノインプリント用組成物を得た。得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を 0.2 μm 穴径のシリンジフィルターにてろ過した。この光硬化性ナノインプリント用組成物の、組成、配合割合を表 1、及び表 2 に示した。

【0163】

得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を用い、硬化膜の基板密着性、離型性、転写性、サファイア選択比、長期間保存安定性を評価した。その結果を表 3 に示した。

【0164】

実施例 2

(光硬化性ナノインプリント用組成物の製造)

窒素ガスで置換したグローブボックス内で、エタノール 9.6 g、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)としてトリメトキシシリルトリメチレンアクリレート(信越化学工業(株)製KBM-5103) 1.5 g、ヘテロポリ酸(B)としてケイタングステン酸 26 水(和光純薬工業製) 0.5 g、有機珪素化合物(E)としてジフェニルジメトキシシラン(東京化成工業(株)製) 5.8 g とを混合した。この混合物を大気雰囲気、室温下 1 時間攪拌し、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)とヘテロポリ酸(B)と有機珪素化合物(E)の混合物を得た。

【0165】

実施例 1 で使用したのと同じ種類、同量の重合性単量体(C)、光重合開始剤(D)、および重合禁止剤とを混合した後、同じ量の混合物(1.0 g)に前記(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)とヘテロポリ酸(B)と有機珪素化合物(E)の混合物 1.2 g とアセチルアセトン 2.8 g を添加後、室温で 15 分間攪拌混合し、光硬化性ナノインプリント用組成物を得た。得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を 0.2 μm 穴径のシリンジフィルターにてろ過した。この光硬化性ナノインプリント用組成物の、組成、配合割合を表 1、及び表 2 に示した。

【0166】

得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を用い、硬化膜の基板密着性、離型性、転写性、サファイア選択比、長期間保存安定性を評価した。その結果を表 3 に示した。

【0167】

実施例 3

(光硬化性ナノインプリント用組成物の製造)

窒素ガスで置換したグローブボックス内で、エタノール 8.5 g、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)としてトリメトキシシリルトリメチレンアクリレート(信越化学工業(株)製KBM-5103) 1.5 g、ヘテロポリ酸(B)としてケイタングステン酸 26 水(和光純薬工業製) 0.5 g、有機珪素化合物(E)としてジフェニルジメトキシシラン(東京化成工業(株)製) 5.8 g とを混合した。

この混合物を攪拌混合しながら、エタノール 2.0 g / 水 0.6 g / 2N-HCl 0.03 g の 2N-HCl / エタノール混合水溶液を室温下、徐々に滴下した。さらに、エタノール 0.5 g / 水 0.1 g のエタノール水溶液を徐々に滴下し、室温下 1 時間攪拌し、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)の加水分解物とヘテロポリ酸(B)と有機珪素化合物(E)の加水分解物を含む混合物を得た。

【0168】

実施例 1 で使用したのと同じ種類、同量の重合性単量体(C)、光重合開始剤(D)、および重合禁止剤とを混合した後、同じ量の混合物(1.0 g)に前記(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)の加水分解物とヘテロポリ酸(B)と有機珪素化合物(E)の加水分解物を含む混合物 4.6 g を添加後、室温で 15 分間攪拌混合し、光硬化性ナノインプリント用組成物を得た。得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を 0.2 μm 穴径のシリンジフィルターにてろ過した。この光硬化性ナノインプリント用組成物の、組成、配合割合を表 1、及び表 2 に示した。

【0169】

10

20

30

40

50

得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を用い、硬化膜の基板密着性、離型性、転写性、サファイア選択比、長期間保存安定性を評価した。その結果を表3に示した。

【0170】

実施例4

(メタ)アクリル基を有する重合性単量体(C)として、ヒドロキシエチル化o-フェニルフェノールアクリレート(新中村化学工業(株)製、NKエステルA-LEN-10)5.0g、9,9-ビス[4-(2-アクリロイルオキシエトキシ)フェニル]フルオレン(新中村化学工業(株)製、NKエステルA-BPEF)5.0gを使用した。

【0171】

光重合開始剤(D)として、2-ジメチルアミノ-2-(4-メチル-ベンジル)-1-(4-モルフォリン-4-イル-フェニル)-ブタン-1-オン(BASFジャパン(株)製、IRGACURE(登録商標)379EG)0.05gを使用した。

10

【0172】

重合禁止剤として、ヒドロキノンモノメチルエーテル0.015g、ブチルヒドロキシトルエン0.002gを使用した。

【0173】

上記(メタ)アクリル基を有する重合性単量体(C)と光重合開始剤(D)と重合禁止剤とを均一に混合し、その混合物を1.0g分取した。該混合物1.0gに、実施例3で得られた(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)の加水分解物とヘテロポリ酸(B)と有機珪素化合物(E)の加水分解物を含む混合物4.6gを添加し、室温で15分間攪拌することにより光硬化性ナノインプリント用組成物を得た。得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を0.2 $\mu$ m穴径のシリンジフィルターにてろ過した。この光硬化性ナノインプリント用組成物の、組成、配合割合を表1、及び表2に示した。

20

【0174】

得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を用い、硬化膜の基板密着性、離型性、転写性、サファイア選択比、長期間保存安定性を評価した。その結果を表3に示した。

【0175】

実施例5

(メタ)アクリル基を有する重合性単量体(C)として、ヒドロキシエチル化o-フェニルフェノールアクリレート(新中村化学工業(株)製、NKエステルA-LEN-10)5.0g、9,9-ビス[4-(2-アクリロイルオキシエトキシ)フェニル]フルオレン(新中村化学工業(株)製、NKエステルA-BPEF)5.0gを使用した。

30

【0176】

光重合開始剤(D)として、2-ジメチルアミノ-2-(4-メチル-ベンジル)-1-(4-モルフォリン-4-イル-フェニル)-ブタン-1-オン(BASFジャパン(株)製、IRGACURE(登録商標)379EG)0.4gを使用した。

【0177】

重合禁止剤として、ヒドロキノンモノメチルエーテル0.015g、ブチルヒドロキシトルエン0.002gを使用した。

【0178】

上記(メタ)アクリル基を有する重合性単量体(C)と光重合開始剤(D)と重合禁止剤とを均一に混合し、その混合物を1.0g分取した。該混合物1.0gに、実施例3で得られた(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)の加水分解物とヘテロポリ酸(B)と有機珪素化合物(E)の加水分解物を含む混合物4.6gを添加し、室温で15分間攪拌することにより光硬化性ナノインプリント用組成物を得た。得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を0.2 $\mu$ m穴径のシリンジフィルターにてろ過した。この光硬化性ナノインプリント用組成物の、組成、配合割合を表1、及び表2に示した。

40

【0179】

得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を用い、硬化膜の基板密着性、離型性、転写性、サファイア選択比、長期間保存安定性を評価した。その結果を表3に示した。

50

## 【0180】

## 実施例6

(光硬化性ナノインプリント用組成物の製造)

窒素ガスで置換したグローブボックス内で、フッ素化有機シラン化合物(F)として(3,3,3-トリフルオロプロピル)トリメトキシシランを固形分1%となるようエタノールで希釈した溶液0.14g、エタノール2.0g、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)としてトリメトキシシリルトリメチレンアクリレート(信越化学工業(株)製KBM-5103)1.5gを混合し、この混合物を攪拌混合しながら、エタノール0.6g/水0.2g/2N-HCl0.03gの2N-HCl/エタノール混合水溶液を室温下、徐々に滴下した。さらに、ヘテロポリ酸(B)としてケイタングステン酸26水(和光純薬工業製)0.5gを混合し、フッ素化有機シラン化合物(F)の加水分解物と(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)の加水分解物とヘテロポリ酸(B)を含む混合物を得た。

10

## 【0181】

実施例1で使用したのと同じ種類、同量の重合性単量体(C)、光重合開始剤(D)、および重合禁止剤とを混合した後、同じ量の混合物(1.0g)に前記フッ素化有機シラン化合物(F)の加水分解物と(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)の加水分解物とヘテロポリ酸(B)を含む混合物5.0gを添加後、室温で15分間攪拌混合し、光硬化性ナノインプリント用組成物を得た。得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を0.2 $\mu$ m穴径のシリンジフィルターにてろ過した。この光硬化性ナノインプリント用組成物の、組成、配合割合を表1、及び表2に示した。

20

## 【0182】

得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を用い、硬化膜の基板密着性、離型性、転写性、サファイア選択比、長期間保存安定性を評価した。その結果を表3に示した。

## 【0183】

## 実施例7

(光硬化性ナノインプリント用組成物の製造)

窒素ガスで置換したグローブボックス内で、フッ素化有機シラン化合物(F)として(3,3,3-トリフルオロプロピル)トリメトキシシランを固形分1%となるようエタノールで希釈した溶液0.14g、エタノール6.5g、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)としてトリメトキシシリルトリメチレンアクリレート(信越化学工業(株)製KBM-5103)1.5gを混合し、この混合物を攪拌混合しながら、エタノール2.0g/水0.2g/2N-HCl0.03gの2N-HCl/エタノール混合水溶液を室温下、徐々に滴下した。さらに、ヘテロポリ酸(B)としてケイタングステン酸26水(和光純薬工業製)0.5g、有機珪素化合物(E)としてジフェニルジメトキシシラン(東京化成工業(株)製)5.8gを混合した。

30

この混合物を攪拌混合しながら、エタノール2.0g/水0.4gのエタノール混合水溶液を室温下、徐々に滴下した。さらに、エタノール0.5g/水0.1gのエタノール水溶液を徐々に滴下し、室温下1時間攪拌し、フッ素化有機シラン化合物(F)の加水分解物と(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)の加水分解物とヘテロポリ酸(B)と有機珪素化合物(E)の加水分解物を含む混合物を得た。

40

## 【0184】

実施例1で使用したのと同じ種類、同量の重合性単量体(C)、光重合開始剤(D)、および重合禁止剤とを混合した後、同じ量の混合物(1.0g)に前記フッ素化有機シラン化合物(F)の加水分解物と(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)の加水分解物とヘテロポリ酸(B)と有機珪素化合物(E)の加水分解物を含む混合物4.7gを添加後、室温で15分間攪拌混合し、光硬化性ナノインプリント用組成物を得た。得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を0.2 $\mu$ m穴径のシリンジフィルターにてろ過した。この光硬化性ナノインプリント用組成物の、組成、配合割合を表1、及び表2に示した。

50

## 【0185】

得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を用い、硬化膜の基板密着性、離型性、転写性、サファイア選択比、長期間保存安定性を評価した。その結果を表3に示した。

## 【0186】

## 実施例8

窒素ガスで置換したグローブボックス内で、エタノール8.5g、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)としてトリメトキシシリルトリメチレンアクリレート(信越化学工業(株)製KBM-5103)7.8g、ヘテロポリ酸(B)としてケイタングステン酸26水(和光純薬工業製)0.1g、有機珪素化合物(E)としてジフェニルジメトキシシラン(東京化成工業(株)製)2.2gとを混合した。

この混合物を攪拌混合しながら、エタノール2.0g/水0.6g/2N-HCl 0.03gの2N-HCl/エタノール混合水溶液を室温下、徐々に滴下した。さらに、エタノール0.5g/水0.1gのエタノール水溶液を徐々に滴下し、室温下1時間攪拌し、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)の加水分解物とヘテロポリ酸(B)と有機珪素化合物(E)の加水分解物を含む混合物を得た。

## 【0187】

実施例1で使用したのと同じ種類、同量の重合性単量体(C)、光重合開始剤(D)、および重合禁止剤とを混合した後、同じ量の混合物(1.0g)に前記(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)の加水分解物とヘテロポリ酸(B)と有機珪素化合物(E)の加水分解物を含む混合物4.6gを添加後、室温で15分間攪拌混合し、光硬化性ナノインプリント用組成物を得た。得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を0.2μm穴径のシリンジフィルターにてろ過した。この光硬化性ナノインプリント用組成物の、組成、配合割合を表1、及び表2に示した。

## 【0188】

得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を用い、硬化膜の基板密着性、離型性、転写性、サファイア選択比、長期間保存安定性を評価した。その結果を表3に示した。

## 【0189】

## 実施例9

(光硬化性ナノインプリント用組成物の製造)

(メタ)アクリル基を有する重合性単量体(C)として、ポリエチレングリコールジアクリレート(新中村化学工業(株)製、NKエステルA-200)5.0g、トリメチロールプロパントリアクリレート(新中村化学工業(株)製、NKエステルA-TMPT)5.0g、トリシクロデカンジメタノールジアクリレート(新中村化学工業(株)製、NKエステルA-DCP)15.0gを使用した。

## 【0190】

光重合開始剤(D)として、2-ジメチルアミノ-2-(4-メチル-ベンジル)-1-(4-モリフォリン-4-イル-フェニル)-ブタン-1-オン(BASFジャパン(株)製、IRGACURE(登録商標)379EG)0.5gを使用した。

## 【0191】

重合禁止剤として、ヒドロキノンモノメチルエーテル0.0375g、ブチルヒドロキシトルエン0.005gを使用した。

## 【0192】

上記(C)と(D)と重合禁止剤とを均一に混合し、その混合物を1.0g分取した。該混合物1.0gに、実施例3で得られた(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)の加水分解物とヘテロポリ酸(B)と有機珪素化合物(E)の加水分解物を含む混合物

8.2gを添加し、室温で15分間攪拌することにより光硬化性ナノインプリント用組成物を得た。得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を0.2μm穴径のシリンジフィルターにてろ過した。この光硬化性ナノインプリント用組成物の、組成、配合割合を表1、及び表2に示した。

10

20

30

40

50

## 【0193】

得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を用い、硬化膜の基板密着性、離型性、転写性、サファイア選択比、長期間保存安定性を評価した。その結果を表3に示した。

## 【0194】

## 実施例10

窒素ガスで置換したグローブボックス内で、フッ素化有機シラン化合物(F)として(3,3,3,-トリフルオロプロピル)トリメトキシシランを固形分1%となるようエタノールで希釈した溶液0.14g、エタノール6.5g、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)としてトリメトキシシリルトリメチレンアクリレート(信越化学工業(株)製KBM-5103)1.5gを混合し、この混合物を攪拌混合しながら、エタノール2.2g/水0.1g/2N-HCl0.03gの2N-HCl/エタノール混合水溶液を室温下、徐々に滴下した。さらに、ヘテロポリ酸(B)としてケイタングステン酸26水(和光純薬工業製)0.5g、有機珪素化合物(E)としてジフェニルシランジオール(東京化成工業(株)製)5.2gとを混合した。

この混合物を室温下1時間攪拌し、フッ素化有機シラン化合物(F)の加水分解物と(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)の加水分解物とヘテロポリ酸(B)と有機珪素化合物(E)を含む混合物を得た。

## 【0195】

実施例1で使用したのと同じ種類、同量の重合性単量体(C)、光重合開始剤(D)、および重合禁止剤とを混合した後、同じ量の混合物(1.0g)に前記フッ素化有機シラン化合物(F)の加水分解物と(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)の加水分解物とヘテロポリ酸(B)と有機珪素化合物(E)を含む混合物3.8gと、アセチルアセトン5.0gを添加後、室温で15分間攪拌混合し、光硬化性ナノインプリント用組成物を得た。

得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を0.2 $\mu$ m 穴径のシリンジフィルターにてろ過した。この光硬化性ナノインプリント用組成物の、組成、配合割合を表1、及び表2に示した。

## 【0196】

得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を用い、硬化膜の基板密着性、離型性、転写性、サファイア選択比、長期間保存安定性を評価した。その結果を表3に示した。

## 【0197】

## 実施例11

(光硬化性ナノインプリント用組成物の製造)

窒素ガスで置換したグローブボックス内で、エタノール6.8g、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)としてトリメトキシシリルトリメチレンアクリレート(信越化学工業(株)製KBM-5103)1.5g、ヘテロポリ酸(B)としてケイタングステン酸26水(和光純薬工業製)0.5g、有機珪素化合物(E)としてトリメトキシフェニルシラン(東京化成工業(株)製)4.7gとを混合した。

この混合物を攪拌混合しながら、エタノール1.6g/水0.6g/2N-HCl0.03gの2N-HCl/エタノール混合水溶液を室温下、徐々に滴下した。さらに、エタノール0.8g/水0.1gのエタノール水溶液を徐々に滴下し、室温下1時間攪拌し、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)の加水分解物とヘテロポリ酸(B)と有機珪素化合物(E)の加水分解物を含む混合物を得た。

## 【0198】

実施例1で使用したのと同じ種類、同量の重合性単量体(C)、光重合開始剤(D)、および重合禁止剤とを混合した後、同じ量の混合物(1.0g)に前記(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)の加水分解物とヘテロポリ酸(B)と有機珪素化合物(E)の加水分解物を含む混合物3.9gを添加後、室温で15分間攪拌混合し、光硬化性ナノインプリント用組成物を得た。得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を0.2 $\mu$ m 穴径のシリンジフィルターにてろ過した。この光硬化性ナノインプリント用組成物

の、組成、配合割合を表 1、及び表 2 に示した。

【 0 1 9 9 】

得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を用い、硬化膜の基板密着性、離型性、転写性、サファイア選択比、長期間保存安定性を評価した。その結果を表 3 に示した。

【 0 2 0 0 】

比較例 1

(光硬化性ナノインプリント用組成物の製造)

窒素ガスで置換したグローブボックス内で、エタノール 8.5 g、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)としてトリメトキシシリルトリメチレンアクリレート(信越化学工業(株)製KBM-5103) 1.5 g、有機珪素化合物(E)としてジフェニルジメトキシシラン(東京化成工業(株)製) 5.8 gとを混合した。

この混合物を攪拌混合しながら、エタノール 2.0 g / 水 0.6 g / 2 N - H C l 0.03 g の 2 N - H C l / エタノール混合水溶液を室温下、徐々に滴下した。さらに、エタノール 0.5 g / 水 0.1 g のエタノール水溶液を徐々に滴下し、室温下 1 時間攪拌し、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)の加水分解物と有機珪素化合物(E)の加水分解物を含む混合物を得た。

【 0 2 0 1 】

実施例 1 で使用したのと同じ種類、同量の重合性単量体(C)、光重合開始剤(D)、および重合禁止剤とを混合した後、同じ量の混合物(1.0 g)に前記(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)の加水分解物と有機珪素化合物(E)の加水分解物を含む混合物 4.5 g を添加後、室温で 15 分間攪拌混合し、光硬化性ナノインプリント用組成物を得た。得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を 0.2 μm 穴径のシリンジフィルターにてろ過した。この光硬化性ナノインプリント用組成物の、組成、配合割合を表 1、及び表 2 に示した。

【 0 2 0 2 】

得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を用い、硬化膜の基板密着性、離型性、転写性、サファイア選択比、長期間保存安定性を評価した。その結果を表 3 に示した。

【 0 2 0 3 】

比較例 2

(光硬化性ナノインプリント用組成物の製造)

窒素ガスで置換したグローブボックス内で、エタノール 6.8 g、ヘテロポリ酸(B)としてケイタングステン酸 26 水(和光純薬工業製) 0.5 g、有機珪素化合物(E)としてジフェニルジメトキシシラン(東京化成工業(株)製) 5.8 gとを混合した。

この混合物を攪拌混合しながら、エタノール 1.6 g / 水 0.6 g / 2 N - H C l 0.03 g の 2 N - H C l / エタノール混合水溶液を室温下、徐々に滴下した。さらに、エタノール 0.4 g / 水 0.1 g のエタノール水溶液を徐々に滴下し、室温下 1 時間攪拌し、ヘテロポリ酸(B)と有機珪素化合物(E)の加水分解物を含む混合物を得た。

【 0 2 0 4 】

実施例 1 で使用したのと同じ種類、同量の重合性単量体(C)、光重合開始剤(D)、および重合禁止剤とを混合した後、同じ量の混合物(1.0 g)に前記ヘテロポリ酸(B)と有機珪素化合物(E)の加水分解物を含む混合物 4.8 g を添加後、室温で 15 分間攪拌混合し、光硬化性ナノインプリント用組成物を得た。得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を 0.2 μm 穴径のシリンジフィルターにてろ過した。この光硬化性ナノインプリント用組成物の、組成、配合割合を表 1、及び表 2 に示した。

【 0 2 0 5 】

得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を用い、硬化膜の基板密着性、離型性、転写性、サファイア選択比、長期間保存安定性を評価した。その結果を表 3 に示した。

【 0 2 0 6 】

比較例 3

(光硬化性ナノインプリント用組成物の製造)

10

20

30

40

50

エタノール 13.6 g、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)としてトリメトキシシリルプロピルアクリレート(信越化学工業(株)製KBM-5103) 3.0 g、有機珪素化合物としてエチルシリケート40(コルコール(株)製テトラエトキシシランの平均5量体物) 6.8 g、金属アルコキシドとして85質量%ジルコニウムブトキシド(テトラブチルジルコニウムアルコキシド)の1-ブタノール溶液 1.7 gとを混合し、この混合物を攪拌混合しながら、エタノール 4.25 g/水 0.85 g/2N-HCl 0.16 gの2N-HCl/エタノール混合水溶液を室温下、徐々に滴下した。さらに、エタノール 1 g/水 0.46 gのエタノール水溶液を徐々に滴下し、室温下1時間攪拌し、(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)と有機珪素化合物と金属アルコキシドの加水分解物を含む混合物を得た。

10

## 【0207】

実施例1で使用したのと同じ種類、同量の重合性単量体(C)、光重合開始剤(D)、および重合禁止剤とを混合した後、同じ量の混合物(1.0 g)に前記(メタ)アクリル基を有する有機珪素化合物(A)と有機珪素化合物と金属アルコキシドの加水分解物を含む混合物 3.6 gを添加後、室温で15分間攪拌混合し、光硬化性ナノインプリント用組成物を得た。得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を0.2 μm 穴径のシリンジフィルターにてろ過した。この光硬化性ナノインプリント用組成物の、組成、配合割合を表1、及び表2に示した。

## 【0208】

得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を用い、硬化膜の基板密着性、離型性、転写性、サファイア選択比、長期間保存安定性を評価した。その結果を表3に示した。

20

## 【0209】

## 実施例12

(表面加工サファイア基板の製造)

実施例3で得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を、アセチルアセトンにて10重量%となるよう希釈した。希釈した光硬化性ナノインプリント用組成物を、サファイア基板(片鏡面、厚さ430 μm、表面粗さRa 0.1 nm、面方位C面)上に、3000 rpm、30秒間でスピコートし、120 °Cにおいて2分間乾燥して、光硬化性ナノインプリント用組成物の塗膜が約100 nmの厚みでコーティングしたサファイア基板を得た。

30

## 【0210】

直径230 nm、深さ200 nmのホールパターンの樹脂性モールドを用い、ミカドテクノス(株)製真空加圧UV硬化装置(VS005-200C-UV)を用い、上記のようにして得られた光硬化性ナノインプリント用組成物の塗膜を有するサファイア基板に、圧力1 MPaをかけメタルハライドランプにて光を60秒間照射して、光ナノインプリントを行った。樹脂モールドを剥離し、サファイア基板上にピラーパターンが転写したサンプルを得た。

## 【0211】

反応性イオンエッチング装置を用いて、上記サンプルを塩素ガスによるドライエッチング条件にて、転写パターンをマスクとして、サファイア基板のドライエッチングによるサファイア基板の表面加工を行った。得られたサンプルをSEM観察したところ、サファイア基板表面がエッチングされ、表面加工できていることを確認した。

40

## 【0212】

## 実施例13

(ナノインプリント用レプリカ金型)

実施例3で得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を、易接着表面処理した厚み188 μmのポリエチレンテレフタレートフィルム上に0.5 ml滴下し、300 mPaで70 °Cにおいて3分間乾燥して揮発成分を蒸発させた。得られた光硬化性ナノインプリント用組成物を有するポリエチレンテレフタレートフィルム上に、ミカドテクノス(株)製真空加圧UV硬化装置(VS005-200C-UV)において、最小パターン80 n

50

mの石英モールド（NTT-ATナノファブ리케이션（株）製、80LRESO）を用い、圧力1MPaをかけメタルハイドランプにて光を30秒間照射して、光ナノインプリントを行い、硬化膜よりなるパターンが形成されたポリエチレンテレフタレートフィルム（積層体）を得た。用いた石英モールドは、あらかじめフッ素系表面処理（ダイキン工業（株）製、オプツールHD-1100TH）で離型処理を施した。硬化膜よりなるパターンが形成されたポリエチレンテレフタレートフィルム（積層体）をナノインプリント用レプリカ金型とするため、パターンを中心に20mm×20mmの大きさにカットした。次いで、離型処理を施すための前処理として、加湿条件下でパターン表面の加水分解処理を行った。該加水分解処理は、上記のカットしたポリエチレンテレフタレートフィルム（積層体）を水の入った容器に入れ、この容器を加熱オーブン中で70℃で2時間加熱処理を行うことにより実施した。その後、処理した積層体のパターン面をフッ素系表面処理剤（ダイキン工業（株）製、オプツールHD-1100TH）と接触させて離型処理を施し、レプリカ金型を作製した。

10

## 【0213】

フッ素処理した転写パターン面に、実施例1で製造した（C）と（D）と重合禁止剤からなる混合物を滴下し、石英板で挟んだ後、ナノインプリント装置（エンジニアリング・システム（株）製EUN-4200）において、圧力0.3MPaをかけLED 375nm光源で石英板側から、光を60秒間照射し、光インプリントを行った。石英板を剥離後、得られたパターン面のSEM観察を行い、使用したモールドと同じパターンに転写できていることを確認した。

20

## 【0214】

【表1】

	メタアクリル基を有する有機珪素化合物（A）	ヘテロポリ酸（B）、または金属アルコキシド	（メタ）アクリル基を有する重合性単量体（C）	光重合開始剤（D）	有機珪素化合物（E）	フッ素化有機シラン化合物（F）	水
実施例1	KBM-5103	ケイタンクステン酸26水	A-LEN-10/A-BPEF	379EG			なし
実施例2	KBM-5103	ケイタンクステン酸26水	A-LEN-10/A-BPEF	379EG	DPDMS		なし
実施例3	KBM-5103	ケイタンクステン酸26水	A-LEN-10/A-BPEF	379EG	DPDMS		あり
実施例4	KBM-5103	ケイタンクステン酸26水	A-LEN-10/A-BPEF	379EG	DPDMS		あり
実施例5	KBM-5103	ケイタンクステン酸26水	A-LEN-10/A-BPEF	379EG	DPDMS		あり
実施例6	KBM-5103	ケイタンクステン酸26水	A-LEN-10/A-BPEF	379EG		TFPS	あり
実施例7	KBM-5103	ケイタンクステン酸26水	A-LEN-10/A-BPEF	379EG	DPDMS	TFPS	あり
実施例8	KBM-5103	ケイタンクステン酸26水	A-LEN-10/A-BPEF	379EG	DPDMS		あり
実施例9	KBM-5103	ケイタンクステン酸26水	A-200/A-TMPI/A-DCP	379EG	DPDMS		あり
実施例10	KBM-5103	ケイタンクステン酸26水	A-LEN-10/A-BPEF	379EG	DPSDO	TFPS	あり
実施例11	KBM-5103	ケイタンクステン酸26水	A-LEN-10/A-BPEF	379EG	TMPS		あり
比較例1	KBM-5103		A-LEN-10/A-BPEF	379EG	DPDMS		あり
比較例2		ケイタンクステン酸26水	A-LEN-10/A-BPEF	379EG	DPDMS		あり
比較例3	KBM-5103	シロコウムゾル	A-LEN-10/A-BPEF	379EG	TEOSの平均5量体物		あり

30

40

## 【0215】

【表 2】

	(メ)アクリ基 を有する有 機珪素化合 物(A) 質量部*	ヘテロリ酸(B) または 金属アルキト* 質量部*	(メ)アクリ基 を有する重 合性単量体 (C) 質量部	光重 合 開始剤 (D) 質量部*	有機珪素 化合物 (E) 質量部*	フッ素化有機シ ラン化合物 (F) 質量部*
実施例 1	13.2	4.4	100	2	—	—
実施例 2	10.6	3.5	100	2	40.9	—
実施例 3	36.1	12.0	100	2	140	—
実施例 4	36.1	12.0	100	0.5	140	—
実施例 5	36.1	12.0	100	4	140	—
実施例 6	30.8	10.3	100	2	—	0.14
実施例 7	36.6	12.2	100	2	142	0.03
実施例 8	168	2.2	100	2	47.4	—
実施例 9	65.0	21.7	100	2	251	—
実施例 10	36.0	12.0	100	2	125	0.03
実施例 11	35.9	12.0	100	2	113	—
比較例 1	36.2	—	100	2	140	—
比較例 2	—	15.5	100	2	180	—
比較例 3	34.8	16.8	100	2	78.9	—

\* (メ)アクリ基を有する重合性単量体 100 質量部に対する各成分の配合量 (質量部)

【 0 2 1 6 】

10

20

30

【表 3】

	塩素エッチング 耐性評価 (サファイア選択比)	密着性評価	離型性評価 (N)	転写性評価	長期間保存 安定性
実施例 1	2.4	5	2	△	○
実施例 2	2.3	5	2	○	○
実施例 3	2.6	5	2	○	○
実施例 4	2.7	5	2	○	○
実施例 5	2.4	5	2	○	○
実施例 6	2.5	5	<1	○	○
実施例 7	2.8	5	<1	○	○
実施例 8	2.2	5	2	○	○
実施例 9	2.1	5	2	○	○
実施例 10	2.6	5	<1	○	○
実施例 11	2.4	5	2	○	○
比較例 1	0.3	5	2	○	○
比較例 2	2.6	1	2	×	○
比較例 3	0.2	5	6	○	×

10

20